

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-294182

(43)Date of publication of application : 04.11.1998

(51)Int.Cl. H05B 33/26
H05B 33/28
// H01B 5/14

(21)Application number : 09-101570 (71)Applicant : IDEMITSU KOSAN CO LTD

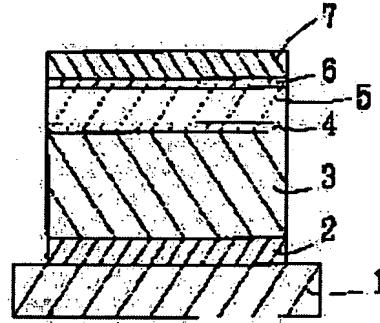
(22)Date of filing : 18.04.1997 (72)Inventor : SHOJI HIROSHI
MATSUURA MASAHIKE
HOSOKAWA CHISHIO

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL element which enables light to be emitted also from its cathode side and used in a high-definition display device, facilitates manufacture of the high-definition display device, and is excellent in durability (moisture and heat resistance).

SOLUTION: This EL element has an organic layer 3 sandwiched between an anode 2 and a cathode, the organic layer 3 containing an organic emission layer. In this case, the cathode comprises an electron injection electrode layer 4, a transparent conductive film 5, and a thin metallic film 6 with a resistivity of $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ or less, which are sequentially deposited from the side making contact with the organic layer 3, with a transparent thin film layer 7 formed outside the cathode. In the above constitution, an organic EL element using an amorphous transparent conductive film is used as the transparent conductive film 7.



LEGAL STATUS

BEST AVAILABLE COPY

[Date of request for examination] 23.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The organic electroluminescent element which is an organic electroluminescent element which comes to pinch the organic layer which contains an organic luminous layer between an anode plate and cathode, and is characterized by coming to form a transparency thin film layer in the outside of cathode while coming to carry out the laminating of the cathode from the side which touches an organic layer in the order of an electronic notes telegram electrode layer, the transparency electric conduction film, and the metal thin film of 1×10 to 5 or less ohm-cm of resistivity.

[Claim 2] The organic electroluminescent element according to claim 1 whose transparency electric conduction film is amorphous transparency electric conduction film.

[Claim 3] The organic electroluminescent element according to claim 2 characterized by forming the amorphous transparency electric conduction film using an indium (In), zinc (Zn), and the oxide that consists of oxygen (O).

[Claim 4] The organic electroluminescent element according to claim 1 to 3 characterized by forming the electronic notes telegram electrode layer in the shape of a super-thin film using one sort chosen from the metal, alloy, and alkaline-earth-metal oxide of electron injection nature, or two sorts or more.

[Claim 5] The organic electroluminescent element according to claim 1 to 3 characterized by an electronic notes telegram electrode layer being a mixing layer of the organic substance of the one sort or two sorts or more, and electron transport nature which are chosen from the metal, alloy, and alkaline-earth-metal oxide of electron injection nature.

[Claim 6] The organic electroluminescent element according to claim 1 to 3 characterized by an electronic notes telegram electrode layer consisting of an island-shape electron injection region.

[Claim 7] The organic electroluminescent element according to claim 2 or 3 characterized by coming to form the transparency electric conduction film in cross-section trapezoidal shape (the shape of a taper) while cathode and an anode plate form XY matrix.

[Claim 8] The organic electroluminescent element characterized by the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer, or the field resistance of cathode being below 10ohms / ** while it is the organic electroluminescent element which comes to pinch the organic layer which contains an organic luminous layer between an anode plate and cathode and the light transmittance of the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer while coming to form a transparency thin film layer in the outside of cathode is 60% or more.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]**[0001]**

[Industrial Application] It relates to an organic electroluminescent element available also as a high definition display while it is available to a transparent light emitting device etc., since this invention can take out luminescence also from the cathode side of a component.

[0002]

[Description of the Prior Art] Since the electroluminescent element (it is hereafter written as an EL element.) using electroluminescence has the descriptions, such as excelling in shock resistance since visibility is high and it is a perfect solid-state component because of self-luminescence, the utilization as a light emitting device in various displays attracts attention.

[0003] There are an inorganic EL element which uses an inorganic compound as a luminescent material, and an organic EL device using an organic compound in an EL element, among these since the miniaturization which can make applied voltage low substantially is easy for an organic EL device, the utilization research is positively made as a next-generation display device. The configuration to which the laminating of the transparency anode plate is carried out is usually adopted on the substrate using [the configuration of an organic EL device] the glass plate etc. on the basis of the configuration of an anode plate / luminous layer / cathode. In this case, luminescence is taken out at a substrate side.

[0004] By the way, the attempt which makes cathode transparency and takes out luminescence to a cathode side by the reason below recent years is made.

(a) A transparent light emitting device can be manufactured.

(b) By adoption of the arbitrary colors as a background color of a light emitting device, it can consider also except the time of luminescence as a colorful display. When black is adopted as a background color, the contrast at the time of luminescence improves.

(c) When using a light filter and a color conversion layer, these can be placed on a light emitting device. For this reason, a component can be manufactured, without taking these layers into consideration. As the advantage, in case an anode plate is made to form, substrate temperature can be made high, and thereby, the resistance of an anode plate can be lowered.

[0005] On the other hand, the indicating equipment (display) using an organic EL device is in highly-minute-izing and the inclination enlarged in recent years. And to use a pixel below as hundreds of micrometer angle is desired for highly-minute-izing. In this case, the scan electrode line and signal-electrode line which constitute a display become thinner, and serve as high resistance in connection with it. There was a problem of causing the delay of the voltage drop according a scan electrode line and a signal-electrode line being high resistance to wiring and the response at the time of actuation. That is, the voltage drop made the display generate brightness nonuniformity, and since the delay of the response at the time of actuation was difficult to display the quick screen of a motion at the time of high definition display production, the problem of receiving constraint was shown in the display. And the scan electrode line and the signal-electrode line are connected with the lower electrode and counterelectrode which constitute an organic EL device. For this reason, making low the resistance of

the anode plate which constitutes a lower electrode and a counterelectrode, or cathode was called for. [0006] The transparent organic EL device which prepared the 2nd electrode layer which becomes JP,8-185984,A from the transparency conductive layer formed the 1st electrode layer which consists of a transparency conductive layer, the electron injection metal layer of a super-thin film, and on it is indicated. However, the technical thought of making resistance of an electrode layer low is not indicated. Moreover, the cathode currently indicated in this official report is specifically ITO (indium tin oxide) and SnO₂ as matter which consists only of one layer of transparency conductive layers, and constitutes this layer. It is indicated. By the way, these matter cannot abolish crystallinity even to extent to which an X diffraction peak disappears, but is crystalline substances intrinsically. For this reason, it faces carrying out a laminating to a substrate through an organic layer, and in order to prevent breakage on an organic layer, when substrate temperature is set as about room temperature -100 degree C and vapor-deposited, a transparency conductive layer with high resistivity is formed (in ITO, it becomes more than 1x10⁻³ ohm-cm extent.).

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] When ****EL** which used the cathode which consists only of one layer of such transparency conductive layers of a crystalline substance was used for a high definition display, the voltage drop occurred with the wiring line of a transparency conductive layer, and since it was possible that heterogeneity arises in luminescence, there was a limitation also in utilization of an organic EL device. Moreover, ITO and SnO₂ Since it is a crystalline substance intrinsically, moisture and oxygen tend to invade from the grain boundary. For this reason, the electron injection metal layer by which a laminating is carried out adjacently tended to receive degradation, as a result, the luminescence defect could arise, or it could consider stopping emitting light etc., and amelioration of the further endurance was desired.

[0008] Furthermore, in the case of the transparency conductive layer of the aforementioned crystalline substance, in the patterning process at the time of producing the organic electroluminescence indicating equipment of XY matrix structure, it may be difficult to adopt the so-called taper etching in which the etching pattern of cross-section trapezoidal shape is made to form by etching, and, for this reason, production of a high definition indicating equipment may be difficult.

[0009] The 1st object of this invention is to offer the organic EL device which can be used for a high definition display while it can solve the technical problem of the above-mentioned conventional technique and can take out luminescence also from the cathode side of a component. It is to offer the organic EL device which is excellent in endurance (resistance to moist heat) while it attains the 1st object, and production of a high definition display is easy for the 2nd object of this invention.

[0010]

[Means for Solving the Problem] this invention persons found out that the organic EL device which has the cathode of low resistance and high transparency was obtained by arranging the metal thin film of low resistance on the outside of the transparency electric conduction film which constitutes cathode, as a result of repeating research wholeheartedly, in order to solve the above-mentioned technical problem. This invention is completed based on this knowledge.

[0011] That is, the summary of this invention is as follows.

[1] Organic electroluminescent element which is an organic electroluminescent element which comes to pinch the organic layer which contains an organic luminous layer between . anode plate and cathode, and is characterized by coming to form a transparency thin film layer in the outside of cathode while coming to carry out the laminating of the cathode from the side which touches an organic layer in the order of an electronic notes telegram electrode layer, the transparency electric conduction film, and the metal thin film of 1x10 to 5 or less ohm-cm of resistivity.

[2] Organic electroluminescent element given in the above [1] whose . transparency electric conduction film is amorphous transparency electric conduction film.

[3] Organic electroluminescent element given in the above [2] characterized by forming . amorphous transparency electric conduction film using an indium (In), zinc (Zn), and the oxide that consists of oxygen (O).

[4] Organic electroluminescent element given in either of aforementioned [1]- [3] characterized by forming . electronic notes telegram electrode layer in the shape of a super-thin film using one sort chosen from the metal, alloy, and alkaline-earth-metal oxide of electron injection nature, or two sorts or more.

[5] Organic electroluminescent element given in either of aforementioned [1]- [3] characterized by . electronic notes telegram electrode layer being a mixing layer of the organic substance of the one sort or two sorts or more, and electron transport nature which are chosen from the metal, alloy, and alkaline-earth-metal oxide of electron injection nature.

[6] Organic electroluminescent element given in either of aforementioned [1]- [3] characterized by . electronic notes telegram electrode layer consisting of an island-shape electron injection region.

[7] The above [2] characterized by coming to form the transparency electric conduction film in cross-section trapezoidal shape (the shape of a taper) while . cathode and an anode plate form XY matrix, or organic electroluminescent element given in [3].

[8] Organic electroluminescent element characterized by the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer, or the field resistance of cathode being below 10ohms / ** while it is the organic electroluminescent element which comes to pinch the organic layer which contains an organic luminous layer between . anode plate and cathode and the light transmittance of the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer while coming to form a transparency thin film layer in the outside of cathode is 60% or more.

[0012]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, this invention is explained to a detail. As an organic EL device which can attain the 1st object of this invention From the side to which it comes to pinch the organic layer which contains an organic luminous layer between an anode plate and cathode, and cathode touches an organic layer to an electronic notes telegram electrode layer While coming to carry out a laminating in the order of the transparency electric conduction film and the metal thin film of 1x10 to 5 or less ohm-cm of resistivity, the thing of a configuration of coming to form a transparency thin film layer in the outside of cathode is employable. Drawing 1 can express this component configuration typically. First, each element and transparency thin film layer which constitute the cathode of this organic EL device are explained.

[0013] A <metal thin film> metal thin film is used in order to lower the field resistance of cathode, and it is thin-film-sized by even extent which can penetrate light. As a metal which can be used by this invention and with which resistivity serves as an ingredient of the metal thin film below 1x10-5ohm and cm, silver (Ag), gold (Au), aluminum (aluminum), a ruthenium (Lu), nickel (nickel), platinum (Pt), etc. can be mentioned, for example. Especially Ag, Au, and Pt which resistivity tends to thin-film-size low are suitable, and especially Ag is suitable. The description of this invention is that it raised the transparency of cathode. For this reason, it is desirable to make light transmittance of a metal thin film layer into 70 - 90%. For that, it is desirable to set thickness to 2-20nm, and it is desirable to especially be referred to as 2-10nm.

[0014] As a method of forming this layer, the sputtering methods, such as resistance heating type vacuum deposition usually used for production of a thin film, electron beam vacuum deposition, RF magnetron, or DC magnetron, are mentioned, for example. Also in these, when an organic layer, an electronic notes telegram electrode layer, a transparency conductive layer, etc. are formed in advance of formation of this layer, it is desirable to use the Helicon sputtering method which is one sort of resistance heating type vacuum deposition with little thermal effect on these layers or DC magnetron sputtering, and especially resistance heating type vacuum deposition is desirable. In this case, since formation by the sputtering method is desirable, as for the transparency electric conduction film which carries out a postscript, it is desirable to choose means forming suitably in consideration of the advantage by share-sizing of equipment or a process.

[0015] In addition, in the organic EL device of this configuration, the lead wire of an electrode will be taken from the transparency thin film layer formed in a metal thin film or its outside, lets a metal thin film, the transparency electric conduction film, and an electronic notes telegram electrode layer pass,

and an electron is injected into an organic layer.

[0016] The transparency electric conduction film which can be used by <transparency electric conduction film> this invention is the ITO film and SnO₂, when adopting the configuration to which the laminating of the aforementioned metal thin film is carried out. Although you may be crystalline substance transparency electric conduction film, such as film, the one where the resistivity of this layer itself is also lower is desirable, and it is desirable that resistivity is specifically 5x10 to 4 or less ohm-cm.

[0017] The amorphous transparency electric conduction film is mentioned as such transparency electric conduction film. As construction material of such amorphous transparency electric conduction film, the oxide film of an In-Zn-O system is desirable. Here, the oxide film of an In-Zn-O system is transparency electric conduction film which consists of amorphous oxide which contains an indium (In) and zinc (Zn) as a main cation element. As for the atomic ratio [In/(In+Zn)] of In, 0.45-0.90 are desirable. It -- this -- it is because conductivity may become low if out of range. As for especially the atomic ratio [In/(In+Zn)] of In, 0.50-0.90 are desirable in respect of conductivity, and 0.70-0.85 are still more desirable.

[0018] The above-mentioned amorphous oxide may contain only In and Zn substantially as a main cation element, and a valence may contain one or more sorts of 3rd elements more than trivalent [forward]. As an example of said 3rd element, although tin (Sn), aluminum (aluminum), antimony (Sb), a gallium (Ga), germanium (germanium), titanium (Ti), etc. are raised, especially the thing that contains Sn in that conductivity improves is desirable. Moreover, the content of the 3rd element is atomic ratio [(all 3rd elements)/(the amount from which In+Zn+(all 3rd elements))] becomes 0.2 or less is desirable.) of the total amount. If the atomic ratio of the total amount of the 3rd element exceeds 0.2, conductivity may become low by dispersion of ion. Especially the desirable atomic ratio of the total amount of the 3rd element is 0.1 or less. In addition, since what was crystallized is inferior to conductivity from an amorphous thing even if a presentation is the same, it is desirable to use the amorphous transparency electric conduction film also from this point.

[0019] An above-mentioned oxide becomes available as transparency electric conduction film by making it a thin film. As for the thickness at this time, it is desirable to be referred to in general as 3-3000nm. It tends to become insufficient [less than 3nm / conductivity], and when it exceeded 3000nm, and light transmission nature falls or an organic EL device is made to transform intentionally or unescapable after the process in which an organic EL device is manufactured, or manufacture, a crack etc. becomes easy to produce it on the transparency electric conduction film. Especially the desirable thickness of the transparency electric conduction film is 5-1000nm, and still more desirable thickness is 10-800nm.

[0020] In the organic EL device of this invention, when cathode is formed through an anode plate and an organic layer on a substrate, the transparency electric conduction film (oxide film) is formed on an electronic notes telegram electrode layer. As the formation technique of the transparency electric conduction film, although chemical vapor deposition besides the sputtering method, a sol gel process, the ion plating method, etc. are employable, the sputtering method is more desirable than the viewpoint of things and simple nature with little thermal effect on an organic layer. In this case, it is necessary to take care that an organic layer does not receive breakage by the plasma generated at the time of sputtering. Moreover, since the thermal resistance of an organic layer is low, it is desirable to make temperature of a substrate into 200 degrees C or less.

[0021] RF or DC magnetron sputtering, and reactive sputtering, ECR sputtering and ion beam sputtering are sufficient as the approach of sputtering. The presentation of a sputtering target and the conditions of sputtering to be used are suitably chosen according to the presentation of the transparency electric conduction film which is going to form membranes etc. In order to avoid thermal effect which was described above, it is suitable to use Helicon sputtering which is a kind of magnetron sputtering.

[0022] When making the transparency electric conduction film of an In-Zn-O system form by RF, DC magnetron sputtering, or Helicon sputtering, it is desirable to use the sputtering target of following (i) - (ii).

(i) The atomic ratio of an indium is a predetermined thing with the sintered compact target which

consists of a constituent of indium oxide and a zinc oxide. Here, although "a thing predetermined in the atomic ratio of an indium" means that from which the atomic ratio $[In/(In+Zn)]$ of In in the film obtained eventually serves as a request value of 0.45-0.90 within the limits, the atomic ratio in a sintered compact target is the thing of 0.50-0.90 in general. This sintered compact target may be a sintered compact which consists of mixture of indium oxide and a zinc oxide, and From one or more sorts of a hexagonal stratified compound expressed with $In_2O_3 (ZnO)_m$ ($m=2-20$), may be the sintered compact which becomes substantial and One or more sorts and In_2O_3 of a hexagonal stratified compound which are expressed with $In_2O_3 (ZnO)_m$ ($m=2-20$) And/or, you may be the sintered compact which becomes substantial from ZnO . in addition, the reason which limits m to 2-20 in said formula showing a hexagonal stratified compound -- m -- said -- it is because it does not become a hexagonal stratified compound if out of range.

[0023] (ii) Sputtering target which consists of an oxide system disk and one or more sorts of oxide system tablets arranged on this disk. From indium oxide or a zinc oxide, an oxide system disk may become substantial and From one or more sorts of a hexagonal stratified compound expressed with $In_2O_3 (ZnO)_m$ ($m=2-20$), may be the sintered compact which becomes substantial and One or more sorts and In_2O_3 of a hexagonal stratified compound which are expressed with $In_2O_3 (ZnO)_m$ ($m=2-20$) And/or, you may be the sintered compact which becomes substantial from ZnO . Moreover, as an oxide system tablet, the same thing as the above-mentioned oxide system disk can be used. The atomic ratio $[In/(In+Zn)]$ of In in the film with which an operating rate is obtained eventually is suitably determined that it will become the request value of 0.45-0.80 within the limits by the presentation list of an oxide system disk and an oxide system tablet.

[0024] As for any sputtering target of the above (i) - (ii), it is desirable that the purity is 98% or more. At less than 98%, the resistance to moist heat (endurance) of the film obtained may fall by existence of an impurity, conductivity may fall, or light transmission nature may fall. More desirable purity is 99% or more, and still more desirable purity is 99.9% or more.

[0025] Moreover, when using a sintered compact target, as for the relative density of this target, considering as 70% or more is desirable. Relative density imitates lowering of a membrane formation rate, and deterioration of membranous quality, and tends to come by less than 70%. More desirable relative density is 85% or more, and is 90% or more still more preferably.

[0026] In order to change variously with the approach of direct sputtering, the presentation of a sputtering target, the property of the equipment to be used, etc., it is difficult to specify generally, but when based on the DC magnetron sputtering method, as for the sputtering conditions in the case of preparing the transparency electric conduction film by the sputtering method, it is desirable to set up as follows, for example. As for the degree of vacuum and target applied voltage at the time of sputtering, it is desirable to set up as follows. the degree of vacuum at the time of sputtering -- about 1.3×10^{-2} to $6.7 \times 100 \text{ Pa}$ -- more -- desirable -- 1.7×10^{-2} - $1.3 \times 100 \text{ Pa}$ extent -- it may be about 4.0×10^{-2} to $6.7 \times 10^{-1} \text{ Pa}$ still more preferably. Moreover, as for the applied voltage of a target, 200-700V are desirable. the degree of vacuum at the time of sputtering -- less than (a pressure is lower than 1.3×10 to 2 Pa) $1.3 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ -- the stability of the plasma -- bad -- $6.7 \times 100 \text{ Pa}$ -- being high (a pressure being higher than $6.7 \times 100 \text{ Pa}$) -- it becomes impossible to make applied voltage to a sputtering target high Moreover, it may become difficult for target applied voltage to obtain a good thin film less than [200V], or a membrane formation rate may be restricted.

[0027] As a controlled atmosphere, the mixed gas of inert gas, such as argon gas, and oxygen gas is desirable. the case where argon gas is used as inert gas -- the mixing ratio (volume ratio) of this argon gas and oxygen gas -- in general -- 1:1 to 99.99:0.01 -- it is preferably referred to as 9:1 to 99.9:0.1. If it separates from this range, low resistance and the film with high light transmission may not be obtained.

[0028] Substrate temperature is suitably chosen according to the thermal resistance of an organic layer within the limits of the temperature from which the organic layer concerned starts neither deformation nor deterioration with heat. Under at a room temperature, since the device for cooling in substrate temperature is needed separately, a manufacturing cost rises. Moreover, a manufacturing cost rises as substrate temperature is heated to an elevated temperature. For this reason, it is desirable to consider as

room temperature -200 degree C. By performing DC magnetron sputtering on conditions which were mentioned above using sputtering targets, such as the above mentioned (i) - (ii), the transparency electric conduction film made into the object can be prepared on an organic layer.

[0029] In the organic EL device which attains the 2nd object of this invention, it is required for the transparency electric conduction film which constitutes cathode to use the amorphous transparency electric conduction film. About the construction material of this amorphous transparency electric conduction film, thickness, and the forming method, it is the same as that of the above.

[0030] The anode plate and cathode which were generally formed in the line are constituted in XY matrix, and a pixel is made to form in the intersection field in the display using an organic EL device. Therefore, in order to enable a high definition display, it is necessary to form an electrode (an anode plate and cathode) thinly. After making an electrode form in the shape of a thin film, patterning is carried out to the shape of a line by etching etc., and, specifically, an electrode is produced. In this case, if an adjoining electrode contacts, formation of a pixel will be checked and it is not desirable.

[0031] Since it becomes possible to control that a level difference piece arises in the metal thin film formed on this in attaining etching which makes a cross section trapezoidal shape (the shape of a taper) and carrying out a laminating from an anode plate side on a substrate, if the amorphous transparency electric conduction film, especially the amorphous transparency electric conduction film produced using the oxide of an In-Zn-O system are used in such high definition patterning, it becomes producible [a high definition organic electroluminescence display]. Moreover, when carrying out a laminating from a cathode side on a substrate and creating an organic EL device, it can control that a level difference piece arises in the anode plate by which a laminating is carried out the organic layer by which a laminating is carried out on cathode, and on it.

[0032] As an approach of etching the transparency electric conduction film in the shape of a taper, dry etching processing is desirable and it is desirable to process it so that the include angle (theta) formed on the base and side face of the transparency electric conduction film formed in the shape of a line may turn into 30 - 60 degrees. As etching gas, the mixed gas of methane and a hydrogen chloride can be used, for example. Although the organic EL device into which the transparency electric conduction film was processed in the shape of a taper was expressed typically, an example is shown in drawing 2.

[0033] A <electronic notes telegram electrode layer>, next an electronic notes telegram electrode layer are explained. An electronic notes telegram electrode layer is a layer of the electrode whose electron injection is possible for the organic layer containing a luminous layer good. In order to obtain a transparency light emitting device, it is desirable that light transmission is 80% or more, and it is desirable for that to use thickness as an about 0.5-20nm super-thin film.

[0034] For example, the layer which set thickness to 1nm - 20nm, using the metal of 3.8eV or less of work functions (metal of electron injection nature), for example, Mg, calcium, Ba, Sr, Li, Yb, Eu, Y, Sc, etc., as an electronic notes telegram electrode layer can be mentioned. In this case, the configuration which gives 60% or more of especially light transmission is desirable. The electronic notes telegram electrode layer using the alloy (alloy of electron injection nature) of the metal (two or more sorts are sufficient.) of the 3.8eV or less of the aforementioned work functions and the metal of 4.0eV or more of work functions as other desirable examples can be mentioned. Although it is sufficient if it is the alloy which can form an electronic notes telegram electrode layer as such an alloy, an aluminium-lithium alloy, a magnesium-aluminium alloy, an indium-lithium alloy, a lead-lithium alloy, a bismuth-lithium alloy, a tin-lithium alloy, an aluminum-calcium alloy, an aluminum-barium alloy, and an aluminum-scandium alloy can be mentioned, for example. Also in this case, it is desirable to set thickness to 1nm - 20nm, and it is desirable to consider as the layer which gives 60% or more of especially light transmission.

[0035] When making an electronic notes telegram electrode layer form using an aforementioned metal or an aforementioned alloy, resistance heating vacuum deposition is used suitably. In this case, it is desirable to set up substrate temperature among 10-100 degrees C, and to set up an evaporation rate among 0.05-20nm/second. Moreover, when vapor-depositing especially an alloy, the evaporation rate of two sorts of metals of 2 yuan can be set up according to an individual using vacuum deposition, and it

can vapor-deposit. In this case, the evaporation rate of Li, Ba, calcium, Sc, Mg, etc. is set up among 0.01-0.1nm/second, and how to set up the evaporation rate of parent metals, such as aluminum, among 1-10nm/second, and to vapor-deposit it simultaneously can be adopted. Moreover, when vapor-depositing an alloy, the vacuum deposition of 1 yuan can also be used. In this case, beforehand, at a desired rate, the vacuum evaporationo pellet or granule which taught the metal of electron injection nature to the parent metal is installed in a resistance heating boat or a filament, and heating vacuum evaporationo is carried out.

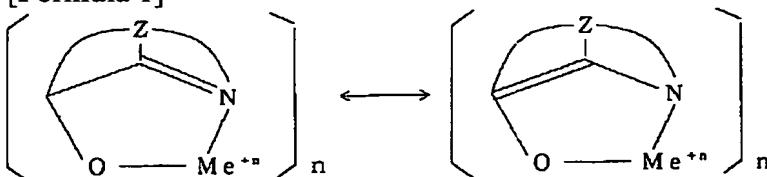
[0036] Furthermore, as another desirable gestalt, it is the alkaline-earth-metal oxide of thin film-like electron injection nature, and the super-thin film whose thickness is 0.1nm - 10nm can be mentioned. As said alkaline-earth-metal oxide, $Ba_x Sr_{1-x} O$ ($0 < x < 1$) which mixed BaO , SrO , CaO , and these, and Ba_x calcium $1-x$ O ($0 < x < 1$) can be preferably mentioned as a thing, for example.

[0037] The approach of making it vapor-deposit, introducing oxygen in a vacuum tub, setting a degree of vacuum to 10⁻³ to ten to 4 Pa as the formation technique of an alkaline-earth-metal oxide layer, vapor-depositing alkaline earth metal with resistance heating vacuum deposition, and making oxygen and an alkaline earth react is desirable. Moreover, the approach of producing alkaline earth metal oxide with electron beam vacuum deposition is also employable. In addition, about the metal of electron injection nature explained until now, an alloy, and an alkaline-earth-metal oxide, an electronic notes telegram electrode layer can also be formed not only using one sort but using two sorts or more.

[0038] Furthermore, as other desirable examples, an electronic notes telegram electrode layer may be a mixing layer of the metal of electron injection nature, an alloy or an alkaline-earth-metal oxide, and the compound of electron transport nature. As the metal of electron injection nature, an alloy, and an alkaline-earth-metal oxide, the above mentioned metal, an alloy, and an alkaline-earth-metal oxide can be mentioned. Moreover, not only one sort but two sorts or more can also be used for these. On the other hand, that the compound of electron transport nature should just be a compound which transmits an electron, as a desirable compound, a chelation oxy-NOIDO compound can be mentioned and what is expressed with a bottom type as a still more suitable compound is mentioned.

[0039]

[Formula 1]



[0040] (Me expresses a metal among a formula and n is the integer of 1-3.) Z shows the atom which completes the nucleus which has at least two fused aromatic rings independently in each case.

Alkali metal like a lithium, sodium, and a potassium, alkaline earth metal like magnesium or calcium, or trivalent metal like boron or aluminum can be mentioned that what is necessary is just 1 - trivalent metal with chelate organization potency as a metal in a formula. Moreover, Z expresses the atom which completes a heterocycle-like nucleus with at least two fused aromatic rings. As a heterocycle-like nucleus which Z completes, an azole ring and an azine ring can be mentioned, for example.

[0041] As said useful chelation oxy-NOIDO compound An aluminum tris oxine, a magnesium screw oxine, bis[(Benzof)-eight quinolinol] zinc, Bis(2-methyl-8-quinolate) aluminum oxide, An indium tris oxine, aluminum tris (5-methyl oxine), Lithium oxine, gallium tris oxine, calcium screw (5-chloro oxine), and Pori [zinc (II)-bis(8-hydroxy-5-KINORI nonyl) methane], dilithium EPINDORI dione, etc. are mentioned.

[0042] Moreover, as for the mixing ratio (weight ratio) of the metal of electron injection nature, an alloy, an alkaline-earth-metal oxide, and the compound of electron transport nature, being referred to as 100:1-1:2 is desirable. As for the mixing layer of the metal of electron injection nature, an alloy, and the compound of electron transport nature, it is desirable to form 2 yuan with simultaneous vacuum

deposition. What is necessary is just to set up substrate temperature among 10-100 degrees C. [0043] Furthermore, as other desirable examples, an electronic notes telegram electrode layer can mention the configuration which is an island-shape electron injection region. Here, as it is indicated in drawing 3 as island shape, it means that the electron injectional compound layer is formed discontinuously and this layer does not cover all the front faces of an organic layer. an island-shape electron injection region -- for example, the metal of the low work function of 3.8eV or less of work functions, an oxide, a HOU-ized metal, a nitriding metal, and silicification -- although a metal etc. is made to form in island shape discontinuously and there is especially no limit about the configuration and size, it has the shape of the shape of a particle, and a crystal, and that whose magnitude is 0.5nm - about 5 micrometers is desirable.

[0044] Moreover, this electron injection region does not show the condition of isolated atom distribution by what points out the shape of a thin film, either. The above-mentioned metal or above-mentioned compound of a low work function points out the condition of distributing on a conductive thin film or in the organic compound layer with the particle-like gestalt. By such distribution, the area in contact with an organic compound layer becomes large, and electron injection nature increases. As the metal and alloy of the low work function which constitutes the above-mentioned island-shape electron injection region, the thing of 3.8eV or less of work functions is desirable, for example, can mention the above mentioned metal and the above mentioned alloy. Moreover, as an oxide of a low work function, the oxide of alkali metal or alkaline earth metal is desirable, and CaO, BaO, SrO, etc. can also mention the solid solution of these and other metallic oxides preferably suitably especially. Furthermore, as the HOU-ized metal and nitriding metal of a low work function, the boride of rare earth, the silicide of rare earth, or TiN is mentioned preferably, for example.

[0045] As the formation approach of an island-shape electron injection region, resistance heating vacuum deposition and electron beam vacuum deposition are employable. A hoe-ized metal, a high-melting nitriding metal, or high-melting oxide is made to form in island shape discontinuously by electron beam evaporation in the case of the latter. In the organic EL device of this invention, in the case of the cathode which uses an electronic notes telegram electrode layer and the amorphous transparency electric conduction film as a component, the electronic notes telegram electrode layer which is easy to deteriorate will be protected by the amorphous transparency electric conduction film, an electronic notes telegram electrode layer can be made thin, and it has as a result the advantage that transparency cathode can be created suitably.

[0046] In the organic EL device of this invention, although the configuration which carries out an anode plate on a substrate and carries out the laminating of the organic layer on laminating *Perilla frutescens* (L.) Britton var. *crispa* (Thunb.) Decne. is usually adopted, an electronic notes telegram electrode layer is formed on the organic layer which contains an organic luminous layer in this case. Although the formation approach is as aforementioned, it has the sputtering method as other desirable approaches. It faces using this technique and it is necessary to take care that an organic layer does not receive breakage by the plasma.

[0047] In the cathode of the configuration of the <transparence thin film layer> above, since an outermost layer of drum serves as a metal thin film, the layer which protects this is needed. Since it is in the 1st object of this invention obtaining the cathode which has light transmission nature, this layer needs to have light transmission nature. Although the well-known thin film made from glass or plastics can also be used as such a layer, when carrying out a laminating from an anode plate side on a substrate and producing an organic EL device, it is desirable to form a transparent dielectric thin film or the transparence electric conduction film on a metal thin film. In using a dielectric thin film, there is an advantage that the transparence protective coat whose light transmittance improved due to the refractive index can be formed.

[0048] as a transparent dielectric thin film -- TiO₂ etc. -- a crystalline thin film can be used. moreover -- as the transparence electric conduction film -- ITO and SnO₂ etc. -- amorphous transparence electric conduction film, such as a crystalline thin film and an In-Zn-O system, can be used. Especially the thing for which the amorphous transparence electric conduction film is used is desirable also in respect of

improvement in the endurance which is the 2nd object of this invention. In this layer, conductivity is not made indispensable. For this reason, when using a transparent dielectric thin film, a lead will be taken from a metal thin film. As the formation approach of this layer, RF magnetron sputtering, especially Helicon sputtering are used suitably.

[0049] While the organic layer which contains an organic luminous layer between an anode plate and cathode again is pinched in the organic EL device which attains the 1st object of <light transmittance and field resistance> this invention The component configuration the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer, or whose field resistance of cathode it is the configuration of coming to form a transparency thin film layer in the outside of cathode, and the light transmittance of the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer is 60% or more, and is below 10ohms / ** is employable. As cathode which fills this configuration, what has the aforementioned configuration can be mentioned suitably, for example. Moreover, the transparency thin film layer is the same as that of the above.

[0050] The light transmittance specified here is the light transmittance to the transparency thin film formed in the outside of cathode from the layer (for example, electronic notes telegram electrode layer) which touches the organic layer which constitutes an organic EL device. light transmittance -- either of the light regions (380-700nm) -- permeability should just become 60% or more on wavelength. What is necessary is just to use a well-known spectrophotometer as a measuring method of light transmittance. Moreover, it is not necessary to produce only the layer which consists of a transparency thin film layer formed in cathode and its outside, and to measure light transmittance, and if light transmittance including other layers is 60% or more, it can be said that the light transmittance of this layer is 60% or more.

[0051] The field resistance (Ω **) specified here is a value measured with the four point probe method. The field resistance of the transparency thin film layer front face which forms the film of the same configuration as the layer which consists of a transparency thin film layer formed in the cathode in the organic EL device concerned and its outside, or the film of the same configuration as cathode, and is specifically formed in cathode or its outside by the four point probe method on an insulating substrate (for example, glass substrate) is measured. At this time, the layer which takes out an electrode lead is chosen as a layer which measures field resistance. That is, when taking out an electrode lead from cathode, field resistance of cathode is measured, and in taking out an electrode lead from the transparency thin film layer formed in the outside of cathode, it measures field resistance of a transparency thin film layer. Thus, the measured field resistance is field resistance which this invention specifies.

[0052] However, in a configuration of that cathode contains an electronic notes telegram electrode layer, the laminating of the layer which excepted this layer is carried out in the same sequence as the case of a actual component configuration, and field resistance is measured. In the case of the EL element which takes out an electrode lead from a transparency thin film layer, on a support substrate (usually glass), carry out a laminating to the order of the transparency electric conduction film, a metal thin film, and a transparency thin film layer, and, specifically, let field resistance of the front face of this transparency thin film layer be the field resistance of this invention. In this case, in taking out an electrode lead from a metal thin film, let field resistance of the front face of a metal thin film be the field resistance of this invention.

[0053] In the organic EL device of <organic layer> this invention, the organic layer which intervenes between an anode plate and cathode contains an organic luminous layer at least. An organic layer may be a layer which consists only of an organic luminous layer, and may be easy to be the thing of the multilayer structure which carried out the laminating of the hole-injection transporting bed etc. with the organic luminous layer.

[0054] In this organic EL device, a luminous layer can pour in an electron hole by the anode plate or the electron hole transporting bed at the time of (1) electric-field impression. And the interior of a luminous layer is provided with the field of recombination of the function in which an electron can be poured in from an electronic notes telegram electrode layer, the transport function, to which the charge (an

electron and electron hole) which carried out (2) impregnation is moved by the force of electric field, (3) electrons, and an electron hole, and it has the luminescence function to tie this to luminescence etc. About the class of luminescent material used for this luminous layer, there is especially no limit and the well-known thing in an organic EL device can be used conventionally.

[0055] Moreover, a hole-injection transporting bed is a layer which consists of an electron hole transfer compound, it has the function to transmit the electron hole poured in from the anode plate to a luminous layer, and many electron holes are poured into a luminous layer by lower electric field by making this hole-injection transporting bed intervene between an anode plate and a luminous layer. Moreover, the electron poured into the luminous layer from the electronic injection layer raises the luminous efficiency of the EL element accumulated near the interface in this luminous layer with the obstruction of the electron which exists in the interface of a luminous layer and a hole-injection transporting bed, and let it be the EL element which was excellent in the luminescence engine performance. About the electron hole transfer compound used for this hole-injection transporting bed, there is especially no limit and it can use a thing conventionally well-known as an electron hole transfer compound in an organic EL device. A hole-injection transporting bed can also be made not only into a monolayer but into a multilayer.

[0056] If, as for a <anode plate> anode plate, a work function shows conductivity 4.8eV or more, there will be especially no limit. That with which the work function combined a metal 4.8eV or more, the transparency electric conduction film (conductive oxide film), or these is desirable. An anode plate may coat a carbon layer that it does not necessarily need to be transparent and black etc.

[0057] As a suitable metal, Au, Pt, nickel, and Pd can be mentioned and In-Zn-O, In-Sn-O, ZnO-aluminum, and Zn-Sn-O can be mentioned as a conductive oxide, for example. Moreover, as a layered product, the layered product of Au and In-Zn-O, the layered product of Pt and In-Zn-O, and the layered product of In-Sn-O and Pt can be mentioned, for example.

[0058] Moreover, as long as an interface with an organic layer is 4.8eV or more of work functions, since it is good, an anode plate may make an anode plate two-layer, and may use the conductive film of 4.8eV or less of work functions for the side which does not touch an organic layer. In this case, alloys, such as metals and aluminum alloys, such as aluminum, Ta, and W, and a Ta-W alloy, etc. can be used. Moreover, microcrystals, such as amorphous semiconductors, such as doped conductive polymers, such as the doped poly aniline and doped polyphenylene vinylene, and alpha-Si, alpha-SiC, alpha-C, muC-Si, and muC-SiC, etc. can be used preferably. furthermore, Cr₂O₃ which is the oxide of black semiconductance, Pr₂O₅, NiO, Mn₂O₅, and MnO₂ etc. -- it can use.

[0059] As for the thickness of an anode plate, it is desirable to be referred to as about 50-300nm. By less than 50nm, resistance may become [thickness] high too much. On the other hand, if it exceeds 300nm, the upside film, for example, an organic layer and cathode, may cause a level difference piece and an open circuit with the level difference produced in an organic EL device at the edge at which the pattern of the anode plate is carried out.

[0060] The organic EL device of <configuration of organic EL device> this invention The organic layer containing an organic luminous layer intervenes between an anode plate and cathode. Cathode An electronic notes telegram electrode layer, The configuration in which it comes to form a transparency thin film layer in the outside of cathode while it is constituted by the transparency electric conduction film and the metal thin film and an electronic notes telegram electrode layer moreover touches an organic layer, Or the light transmittance of the layer which consists of a transparency thin film formed in cathode and its outside while coming to pinch the organic layer which contains an organic luminous layer between an anode plate and cathode is 60% or more. And if the configuration the layer which consists of cathode and said transparency thin film layer, or whose field resistance of cathode is below 10ohms / ** is provided, the 1st object of this invention can be attained. Moreover, the 2nd object of this invention can be attained by adopting the amorphous transparency electric conduction film as transparency electric conduction film in the above-mentioned organic EL device.

[0061] Furthermore, other configurations can be added and various functions can be given. The configuration which used the organic EL device of this invention for below is illustrated.

** transparency anode plate / organic layer/- electronic notes telegram electrode layer / amorphous

transparence electric conduction film / metal thin film / transparence electric conduction film ** anode plate / organic layer / electronic notes telegram electrode layer -- amorphous -- transparence electric conduction film / metal thin film / transparence electric conduction film / light filter ** anode plate / organic layer / electronic notes telegram electrode layer -- the amorphous transparence electric conduction film / metal thin film / transparence electric conduction film / color conversion layer ** A transparence anode plate / organic layer / electronic notes telegram electrode layer / amorphous substance transparence electric conduction film / metal thin film / transparence electric conduction film / black optical absorption layer ** transparence anode plate / organic layer / electronic notes telegram electrode layer / amorphous substance transparence electric conduction film / metal thin film / transparence electric conduction film /background color formative layer ** -- black -- optical absorption layer / transparence anode plate / organic layer / electronic notes telegram electrode layer -- amorphous -- transparence electric conduction film / metal thin film / transparence electric conduction film ** background color formative layer / transparence anode plate / organic layer / electronic notes telegram electrode layer -- amorphous, since both electrodes are transparence in the configuration of the transparence electric conduction film / metal thin film / the transparence electric conduction film aforementioned ** A transparence display device is formed.

[0062] ** Since in the configuration of ** an anode plate is formed on a support substrate and ejection of luminescence is made to hard flow with a support substrate, it is not necessary to form an anode plate on a light filter or a color conversion layer. Therefore, in case an anode plate is formed, when a process from which substrate temperature becomes 150 degrees C or more can be adopted and the resistance of an anode plate is lowered, there is a big merit. Moreover, since a light filter and a color conversion layer are formed after anode plate formation, they do not need to worry about degradation by adoption of an elevated-temperature process. The configuration of ** is illustrated to drawing 4. In addition, it is desirable that it is what consists of a transparency polymer containing fluorescence coloring matter as a color conversion layer here, and changes EL luminescent color into another color according to fluorescence.

[0063] Moreover, since auxiliary wiring of those other than an anode plate and TFT (Thin Film Transister) are formed on a substrate with the configuration of ** or ** in the mode which made many pixels constitute, when light is taken out in the direction of a substrate, auxiliary wiring and TFT intercept light, the numerical aperture of optical ejection falls, the brightness of a display becomes small as a result, and there is a fault that image quality falls off. With a substrate, if this invention is used, although ejection of light can be performed towards reverse, light will not be intercepted in this case and the numerical aperture of optical ejection will not fall.

[0064] ** In the configuration of **, since it looks black when a pixel is OFF, incidence outdoor daylight does not reflect but there is an advantage that the contrast of a display improves. The configuration of ** is illustrated to drawing 5. ** In the configuration of **, various background colors and patterns are employable, and also when a pixel is OFF, it can consider as the display which is excellent in fanciness. The configuration of ** is illustrated to drawing 6.

[0065] In addition, in the configuration of the aforementioned ** - **, as long as it is not necessary to necessarily stick to an electrode, it may make an interlayer intervene and the effectiveness is discovered, it may detach and a color conversion layer, a light filter, a black optical absorption layer, and the background color formative layer may be installed, as shown in drawing 4. However, a color conversion layer and a light filter need to be installed in the direction of optical ejection, and a black optical absorption layer and the background color formative layer need to be installed in hard flow with the direction of optical ejection.

[0066]

[Example] Hereafter, the example of this invention is explained.

[Example 1]

On the <production of organic EL device> 25mmx75mmx1mm glass substrate, what produced ITO by 100nm thickness (JIOMA tex company make) was used as what the conductive thin film (anode plate) has formed on the substrate. Next, after immersing this into isopropyl alcohol and performing ultrasonic

cleaning, ultraviolet rays and ozone were used together using UV irradiation opportunity UV-300 by SAMUKO International, and it washed for 30 minutes.

[0067] Subsequently, this glass substrate with an ITO thin film was put in into the commercial vacuum evaporator, and installation and a vacuum tub were decompressed up to 5x10 to 4 Pa in the substrate electrode holder currently installed in this equipment. Beforehand in addition, on the resistance heating boat of a vacuum evaporation system The phthalocyanine of Cu coordination (it is hereafter written as CuPc.) N, N'-bis(3-methylphenyl)-N, N'-diphenyl - (1 and 1'-biphenyl) -4, 4'-diamine (it is hereafter written as TPD.) And an eight-quinolinol aluminum complex (it is written as Alq an aluminum tris oxine and the following.) It put in 200mg at a time, respectively, and the aluminium-lithium alloy (Li content: 2 % of the weight) was put into the resistance heating filament. Each component was vapor-deposited by carrying out sequential heating of these boats and filaments.

[0068] First, 25nm of CuPc(s) was vapor-deposited to the glass substrate with an ITO thin film as a hole-injection transporting bed, then, 40nm of TPD(s) was vapor-deposited as 2nd hole-injection transporting bed, and 60nm of Alq(s) was further vapor-deposited as a luminous layer. Next, the mask was installed on the formed layered product, 7nm of aluminium-lithium alloys was vapor-deposited, and the electronic notes telegram electrode layer was made to form.

[0069] Next, the substrate was transported and set to the substrate electrode holder of another vacuum tub connected with the above-mentioned vacuum evaporator. In addition, a degree of vacuum is maintained in the meantime. The above and another vacuum tub are furnished so that the In-Zn-O system oxide film can be formed by DC magnetron sputtering. The target for making the In-Zn-O system oxide film form is In₂O₃. It is the sintered compact which consists of ZnO, and the atomic ratio [In/(In+Zn)] of In is 0.67. The mixed gas (it is 1000:2.8 at a volume ratio) of the argon gas and oxygen gas of this vacuum tub was introduced until it was set to 3x10 to 1 Pa, the sputtering output was set as 20W, substrate temperature was set as the room temperature, and the amorphous transparence electric conduction film of 100nm of thickness was made to form. In addition, that the In-Zn-O system oxide film is amorphous formed the layered product by the same approach as the above using the glass substrate with which the ITO thin film is not vapor-deposited, and it checked it according to the X diffraction.

[0070] Next, the controlled atmosphere was used as the argon, the pressure was set to 3x10 to 1 Pa, the sputtering output was set as 10W, substrate temperature was set as the room temperature, and 5nm laminating of the silver (Ag) was carried out by DC magnetron sputtering. 100nm laminating of the In-Zn-O system oxide film was carried out according to the after that still more nearly same conditions as the above, and the organic EL device was produced.

[0071] When the layered product which carried out the laminating of an electronic notes telegram electrode layer, the amorphous transparence electric conduction film, a silver thin film, and the In-Zn-O system oxide film directly on the glass substrate with an ITO thin film was created using the production approach of the component of which the <assessment of light transmittance and field resistance> above was done, and the same approach and the permeability of light with a wavelength of 460nm was measured using the spectrophotometer, it was the thing of 60% and high transparence. Furthermore, when the laminating of the amorphous transparence electric conduction film and the silver thin film was directly carried out on the glass substrate, the laminating of the In-Zn-O system oxide film was carried out on it using the production approach of the above mentioned component, and the same approach and the field resistance of this oxide film front face was measured using RORESUTA FP by Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd., they were 10ohm/**.

[0072] When <assessment of an organic EL device>, next an ITO thin film were made into the anode plate, the electrode lead was taken from the In-Zn-O system oxide film and the electrical potential difference was impressed 7V among both thin films, it is 2.8 mA/cm². When it became current density and being observed from the cathode side, it is 60 cd/m². There was luminescence. Luminescence was green luminescence produced from Alq. Furthermore, when this component was left in the ambient atmosphere of RH (relative humidity) 70% among atmospheric air for 100 hours, with the naked eye, the point emitting [-less] light was not observed, but the luminescence engine performance of a component

was also maintained.

[0073] [The example 1 of a comparison]

The organic EL device was produced by the same approach as the <production of organic EL device> example 1. However, instead of making the thin film of three layers which consists of the amorphous transparency electric conduction film, a silver thin film, and In-Zn-O system oxide film form on an electronic notes telegram electrode layer, the commercial ITO target was used and 200nm much more ITO film was made to form. The controlled atmosphere, its pressure, the sputtering approach, and output at the time of making this ITO film form were also made to be the same as that of an example 1.

[0074] It was 80%, when the layered product which made an electronic notes telegram electrode layer and the ITO film form directly on a glass substrate with an ITO thin film was produced using the production approach of the component of which the <assessment of light transmittance and field resistance> above was done, and the same approach and the permeability of light was measured like the example 1. Furthermore, when the laminating of the ITO film was directly carried out on the glass substrate and the field resistance of the front face was measured by the same approach as an example 1 using the production approach of the above mentioned component, and the same approach, they were 130ohm/**.

[0075] When the electrical potential difference was impressed to <assessment of an organic EL device>, next this organic EL device 8V, it is 4 mA/cm². When it became current density and being observed from the amorphous transparency electric conduction film side, it is 60 cd/m². There was luminescence. Luminescence was green luminescence produced from Alq. When this component was left in the ambient atmosphere of RH 70% among atmospheric air for 100 hours, the countless check of the point emitting [-less] light was carried out with the naked eye, and it was checked that there are many luminescence defects.

[0076] Since the organic EL device of an example 1 has the high transparency of cathode, and luminous efficiency was higher than the above result since cathode is low resistance, and the In-Zn-O thin film which constitutes the layer which touches an outermost layer of drum and an electronic notes telegram electrode layer further was amorphous, it excelled in endurance and it was checked that it is hard to produce a luminescence defect. By the way, it is known that a luminescence defect will arise by oxidation of an electronic notes telegram electrode layer. With the organic EL device of this invention, since the amorphous transparency electric conduction film is formed as a layer which touches an outermost layer of drum and an electronic notes telegram electrode layer and the grain boundary does not exist in this transparency electric conduction film, trespass of oxygen or moisture is prevented and it is thought that the aforementioned result was brought. On the other hand, although the transparency of cathode of the example 1 of a comparison was high, since the resistance of cathode was high, it was checked that it is inferior to luminous efficiency.

[0077] [Example 2]

In the <production of organic EL device> example 1, it replaced with the In-Zn-O system oxide thin film formed at the end, and the organic EL device was produced by the same approach as an example 1 except having made the ITO thin film form so that it may become 100nm of thickness by DC magnetron sputtering. The ITO thin film introduced the ITO target until it was set to 3x10 to 1 Pa in the mixed gas (it is 1000:2.8 at a volume ratio) of argon gas and oxygen gas, the sputtering output was set as 20W, and it set substrate temperature as the room temperature, and made the thin film of 100nm of thickness form.

When the layered product which carried out the laminating of an electronic notes telegram electrode layer, the amorphous transparency electric conduction film, a silver thin film, and the ITO film directly on the glass substrate with an ITO thin film was created using the production approach of the component of which the <assessment of light transmittance and field resistance> above was done, and the same approach and the permeability of light with a wavelength of 460nm was measured, it was the thing of 80% and high transparency. Furthermore, when the laminating of the amorphous transparency electric conduction film and the silver thin film was directly carried out on the glass substrate, the laminating of the ITO film was carried out on it using the production approach of the above mentioned component,

and the same approach and the field resistance of this ITO film front face was measured like the example 1, they were 5ohm/**.

[0078] When the electrode lead was taken from the ITO film which made the anode plate <assessment of an organic EL device>, next the ITO thin film by which the direct laminating was carried out to the glass substrate, and carried out the laminating to the last and the electrical potential difference was impressed 6V among both thin films, it is 2.5 mA/cm². When it became current density and being observed from the cathode side, it is 60 cd/m². There was luminescence. Luminescence was green luminescence produced from Alq. Furthermore, when this component was left in the ambient atmosphere of RH (relative humidity) 70% among atmospheric air for 100 hours, with the naked eye, the point emitting [-less] light was not observed, but the luminescence engine performance of a component was also maintained.

[0079] [Example 3]

It replaces with the In-Zn-O oxide thin film formed at the end while setting to 200nm thickness of the In-Zn-O oxide thin film formed first in the <production of organic EL device> example 1, and is TiO₂. It used and the organic EL device was produced by the same approach as an example 1 except having made the thin film of 100nm of thickness form by RF magnetron sputtering. TiO₂ As a controlled atmosphere, argon gas was introduced until it was set to 3x10 to 1 Pa, the sputtering output was set as 20W, substrate temperature was set as the room temperature, and the thin film of 100nm of thickness was made to form in the case of formation of a thin film.

[0080] The production approach of the component of which the <assessment of light transmittance and field resistance> above was done, and the same approach are used, and it is a direct and electronic notes telegram electrode layer, the amorphous transparency electric conduction film, a silver thin film, and TiO₂ on a glass substrate with an ITO thin film. When the layered product which carried out the laminating of the thin film was created and the permeability of light with a wavelength of 460nm was measured, it was the thing of 85% and high transparency. Furthermore, when the laminating of the amorphous transparency electric conduction film and the silver thin film was directly carried out on the glass substrate and the field resistance of a silver thin film front face was measured like the example 1 using the production approach of the above mentioned component, and the same approach, they were 10ohm/**.

[0081] When <assessment of an organic EL device>, next an ITO thin film were made into the anode plate, the electrode lead was taken from the silver thin film and the electrical potential difference was impressed 7V among both thin films, it is 3.0 mA/cm². When it became current density and being observed from the cathode side, it is 80 cd/m². There was luminescence. Luminescence was green luminescence produced from Alq.

[0082] Furthermore, when this component was left in the ambient atmosphere of RH (relative humidity) 70% among atmospheric air for 100 hours, with the naked eye, the point emitting [-less] light was not observed, but the luminescence engine performance of a component was also maintained. Since the organic EL device of examples 2 and 3 has the high transparency of cathode, and luminous efficiency was higher than the above result since cathode is low resistance, and the In-Zn-O thin film which constitutes the layer which touches an electronic notes telegram electrode layer further was amorphous, it excelled in endurance and it was checked that it is hard to produce a luminescence defect.

[0083]

[Effect of the Invention] Since the organic EL device which attains the 1st object of this invention has the cathode of low resistance and high transparency, while it can take out luminescence from both sides of a component efficiently, also when it uses for a high definition display, there is little generating of brightness nonuniformity and its delay of the response at the time of actuation is small.

[0084] Since the organic EL device which attains the 2nd object of this invention can perform taper etching processing of cathode while attaining the 1st object, production of high definition organic electroluminescence luminescence equipment is easy for it. Moreover, the organic EL device which attains the 2nd object of this invention is excellent in endurance (resistance to moist heat). Since the organic EL device of this invention has the above effectiveness, it is used suitable for the display of

information machines and equipment etc.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the sectional view showing the configuration of an example of the organic EL device of this invention.

[Drawing 2] In the organic EL device of this invention, it is the sectional view showing an example at the time of adopting the cross-section taper-like amorphous transparency electric conduction film.

[Drawing 3] In the organic EL device of this invention, an island-shape electron injection region is the sectional view showing an example in the case of existing in the interface of the amorphous transparency electric conduction film and an organic layer.

[Drawing 4] It is the sectional view in which simplifying and showing an example of the utilization mode of the organic EL device of this invention, and showing the configuration which added the light filter to the outside of the amorphous transparency electric conduction film.

[Drawing 5] It is the sectional view in which simplifying and showing an example of the utilization mode of the organic EL device of this invention, and showing the configuration which equipped the outside of the amorphous transparency electric conduction film with the black absorption layer.

[Drawing 6] It is the sectional view in which simplifying and showing an example of the utilization mode of the organic EL device of this invention, and showing the configuration which equipped the outside of a transparency anode plate with the background color formative layer.

[Description of Notations]

- 1: Substrate
- 2: Anode plate
- 3: Organic layer
- 4: Electronic notes telegram electrode layer
- 5: Transparency electric conduction film
- 6: Metal thin film
- 7: Transparency thin film layer
- 8: Island-shape impregnation region
- 9: Light filter
- 10: Black optical absorption layer
- 11: Background color formative layer

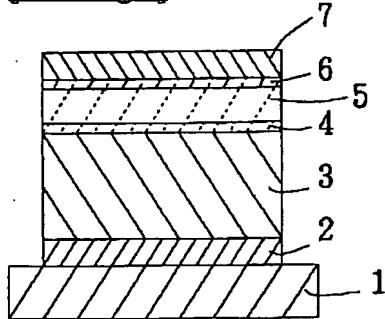
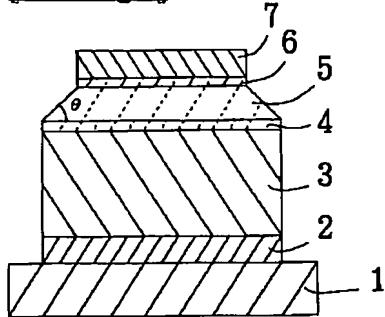
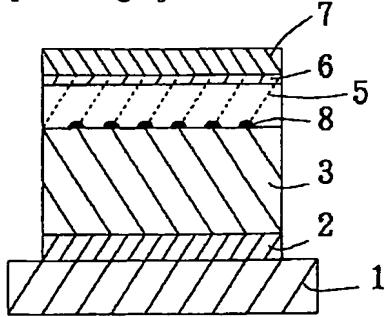
[Translation done.]

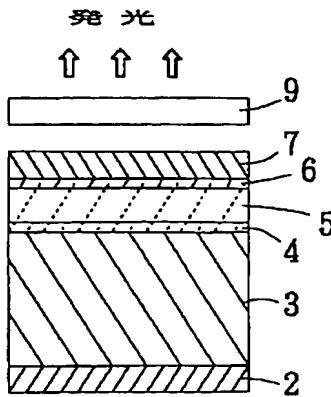
*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any
damages caused by the use of this translation.

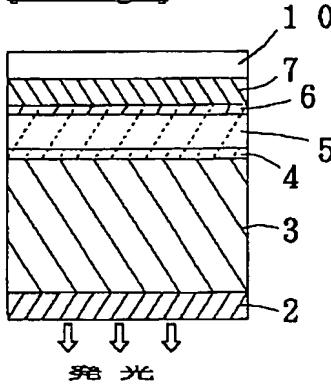
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

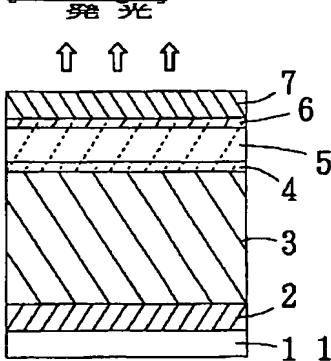
[Drawing 1]**[Drawing 2]****[Drawing 3]****[Drawing 4]**



[Drawing 5]



[Drawing 6]



[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-294182

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日

(51)Int.Cl.⁶
H 0 5 B 33/26
33/28
// H 0 1 B 5/14

識別記号

F I
H 0 5 B 33/26
33/28
H 0 1 B 5/14

A

審査請求 未請求 請求項の数8 O.L (全12頁)

(21)出願番号 特願平9-101570

(22)出願日 平成9年(1997)4月18日

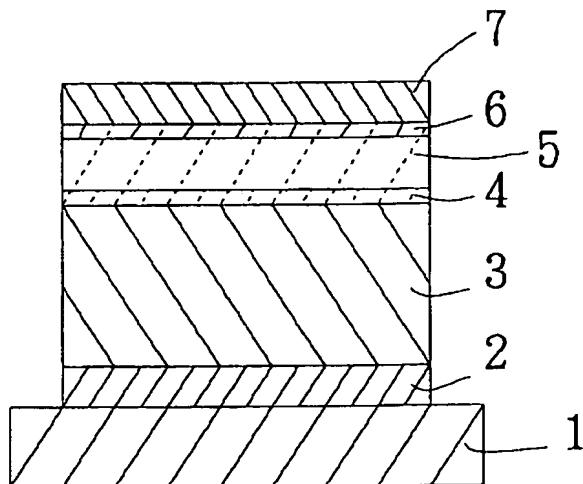
(71)出願人 000183646
出光興産株式会社
東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
(72)発明者 東海林 弘
千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
(72)発明者 松浦 正英
千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
(72)発明者 細川 地潮
千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
(74)代理人 弁理士 東平 正道

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 陰極側からも発光が取り出せる、高精細な表示装置に利用できる有機エレクトロルミネッセンス素子 (EL素子) の提供。前記に加え、高精細な表示装置の作製が容易であるとともに耐久性 (耐湿熱性) に優れる有機EL素子の提供。

【解決手段】 陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなる有機EL素子であって、陰極が、有機層に接する側から電子注入電極層、透明導電膜、抵抗率 $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の金属薄膜の順に積層されてなるとともに、陰極の外側の透明薄膜層が形成されてなる有機EL素子を用いる。前記の構成において、透明導電膜として、非晶質透明導電膜を用いた有機EL素子を用いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、陰極が、有機層に接する側から電子注入電極層、透明導電膜、抵抗率 $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の金属薄膜の順で積層されてなるとともに、陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】透明導電膜が非晶質透明導電膜である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】非晶質透明導電膜が、インジウム(I n)、亜鉛(Zn)、酸素(O)からなる酸化物を用いて、形成されていることを特徴とする請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】電子注入電極層が、電子注入性の金属、合金およびアルカリ土類金属酸化物から選ばれる1種または2種以上を用いて、超薄膜状に形成されていることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】電子注入電極層が、電子注入性の金属、合金およびアルカリ土類金属酸化物から選ばれる1種または2種以上と電子伝達性の有機物の混合層であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】電子注入電極層が、島状電子注入域からなることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】陰極と陽極がXYマトリックスを形成するとともに、透明導電膜が断面台形状(テーパー状)に形成されてなることを特徴とする請求項2または3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなるとともに、陰極と前記透明薄膜層からなる層の光透過率が60%以上であるとともに、陰極と前記透明薄膜層からなる層または陰極の面抵抗値が $10 \Omega / \square$ 以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、発光を素子の陰極側からも取り出すことができるため透明な発光素子等に利用可能であるとともに、高精細な表示装置としても利用可能な有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0002】

【従来の技術】電界発光を利用したエレクトロルミネッセンス素子(以下、EL素子と略記する。)は、自己発光のため視認性が高く、かつ完全固体素子であるため、耐衝撃性に優れるなどの特徴を有することから、各種表示装置における発光素子としての利用が注目されてい

る。

【0003】EL素子には、発光材料として無機化合物を用いる無機EL素子と、有機化合物を用いる有機EL素子とがあり、このうち、有機EL素子は、印加電圧を大幅に低くし得る小型化が容易であるため、次世代の表示素子としてその実用化研究が積極的になされている。有機EL素子の構成は、陽極/発光層/陰極の構成を基本とし、ガラス板等を用いた基板上に、透明陽極を積層する構成が通常採用されている。この場合、発光は基板側に取り出される。

【0004】ところで、近年以下の理由で、陰極を透明にして発光を陰極側に取り出す試みがなされている。

(ア) 透明な発光素子が製造できる。

(イ) 発光素子の背景色としての任意な色の採用により、発光時以外もカラフルなディスプレイとすることができる。背景色として黒を採用した場合には、発光時のコントラストが向上する。

(ウ) カラーフィルターや色変換層を用いる場合に、発光素子の上にこれらを置くことができる。このため、これらの層を考慮することなく素子を製造することができる。その利点として、例えば、陽極を形成させる際に基板温度を高くすることができ、これにより陽極の抵抗値を下げることができる。

【0005】一方、近年、有機EL素子を利用した表示装置(ディスプレイ)は、高精細化および大型化される傾向にある。そして、高精細化のため、画素を数百 μm 角以下とすることが望まれている。この場合、ディスプレイを構成する走査電極線や信号電極線はより細くなり、それに伴い高抵抗となる。走査電極線や信号電極線が高抵抗であると、配線による電圧降下や、駆動時の応答の遅れを引き起こすという問題があった。すなわち、電圧降下はディスプレイに輝度ムラを発生させ、駆動時の応答の遅れは、高精細なディスプレイ作製時、動きの速い画面を表示するのが困難であるため、表示に制約を受けるという問題があった。そして、走査電極線や信号電極線は、有機EL素子を構成する下部電極や対向電極と接続している。このため、下部電極や対向電極を構成する陽極あるいは陰極の抵抗値を低くすることが求められていた。

【0006】特開平8-185984号公報には、透明導電層よりなる第1の電極層と、超薄膜の電子注入金属層及びその上に形成される透明導電層よりなる第2の電極層を設けた、透明な有機EL素子が開示されている。しかし、電極層の抵抗を低くするという技術思想は開示されていない。また、この公報で開示されている陰極は、透明導電層一層のみからなるものであり、この層を構成する物質としては、具体的にはITO(インジウムチンオキサイド)、SnO₂のみが開示されている。ところで、これらの物質はX線回折ピークが消失する程度にまで結晶性をなくすることはできず、本質的に結晶質

50

である。このため、有機層を介して基板に積層するに際して、有機層の損傷を防ぐために基板温度を室温～100°C近くに設定して蒸着した場合、抵抗率が高い透明導電層が形成される（ITOでは、 $1 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$ 程度以上となる。）。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】このような、結晶質の透明導電層一層のみからなる陰極を使用した有機EL素子を高精細な表示装置に利用した場合には、透明導電層の配線ラインで電圧降下が発生し、発光に不均一性が生じることが考えられるため、有機EL素子の利用にも限界があった。また、ITOやSnO₂は、本質的に結晶質であるため、結晶粒界より水分や酸素が侵入しやすい。このため、隣接して積層される電子注入金属層が劣化をうけ易く、その結果発光欠陥が生じたり、発光しなくなったりすることなどが考えられ、更なる耐久性の改良が望まれていた。

【0008】更に、前記の結晶質の透明導電層の場合、XYマトリックス構造の有機EL表示装置を作製する際のバーニング工程において、エッチャリングにより断面台形状のエッチャリングパターンを形成させる、いわゆるテーパーエッチャリングを採用することが難しく、このため高精細な表示装置の作製が難しい場合がある。

【0009】本発明の第1の目的は、上記従来技術の課題を解決し、発光を素子の陰極側からも取り出すことができるとともに、高精細な表示装置に利用できる有機EL素子を提供することにある。本発明の第2の目的は、第1の目的を達成するとともに、高精細な表示装置の作製が容易であるとともに耐久性（耐湿熱性）に優れる有機EL素子を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、陰極を構成する透明導電膜の外側に低抵抗の金属薄膜を配置することにより、低抵抗かつ高透明の陰極を有する有機EL素子が得られることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成させたものである。

【0011】すなわち、本発明の要旨は以下のとおりである。

〔1〕. 陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、陰極が、有機層に接する側から電子注入電極層、透明導電膜、抵抗率 $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の金属薄膜の順で積層されてなるとともに、陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔2〕. 透明導電膜が非晶質透明導電膜である前記〔1〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔3〕. 非晶質透明導電膜が、インジウム（In）、亜鉛（Zn）、酸素（O）からなる酸化物を用いて、形成

されていることを特徴とする前記〔2〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔4〕. 電子注入電極層が、電子注入性の金属、合金およびアルカリ土類金属酸化物から選ばれる1種または2種以上を用いて、超薄膜状に形成されていることを特徴とする前記〔1〕～〔3〕のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔5〕. 電子注入電極層が、電子注入性の金属、合金およびアルカリ土類金属酸化物から選ばれる1種または2種以上と電子伝達性の有機物の混合層であることを特徴とする前記〔1〕～〔3〕のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔6〕. 電子注入電極層が、島状電子注入域からなることを特徴とする前記〔1〕～〔3〕のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔7〕. 陰極と陽極がXYマトリックスを形成するとともに、透明導電膜が断面台形状（テーパー状）に形成されてなることを特徴とする前記〔2〕または〔3〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〔8〕. 陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなるとともに、陰極と前記透明薄膜層からなる層の光透過率が60%以上であるとともに、陰極と前記透明薄膜層からなる層または陰極の面抵抗値が $10 \Omega / \square$ 以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の第1の目的を達成することのできる有機EL素子としては、陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなり、陰極が有機層に接する側から電子注入電極層、透明導電膜、抵抗率 $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の金属薄膜の順で積層されてなるとともに陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなる構成のものを採用することができる。この素子構成は、例えば、図1により模式的に表すことができる。まず、この有機EL素子の陰極を構成する各要素および透明薄膜層について説明する。

【0013】<金属薄膜>金属薄膜は、陰極の面抵抗値を下げるために用いられるものであり、光が透過できる程度にまで薄膜化されたものである。本発明で用いることができる、抵抗率が $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の金属薄膜の材料となる金属としては、例えば、銀（Ag）、金（Au）、アルミニウム（Al）、ルテニウム（Lu）、ニッケル（Ni）、プラチナ（Pt）等を挙げることができる。中でも、抵抗率が低く薄膜化しやすいAg、Au、Ptが好適であり、Agが特に好適である。本発明の特徴は、陰極の透明性を高めた点にある。このため、金属薄膜層の光透過率を70～90%とすることが好ましい。このためには、膜厚を2～20nmとするのが好ましく、2～10nmとするのが特に好ましい。

【0014】この層の成膜法としては、例えば、薄膜の作製に通常使用される抵抗加熱式蒸着法、電子ビーム蒸着法、R FマグネットロンあるいはDCマグネットロン等のスパッタリング法が挙げられる。これらの中でも、この層の形成に先立って、有機層、電子注入電極層、透明導電層等が形成される場合には、これらの層への熱的影響の少ない抵抗加熱式蒸着法あるいはDCマグネットロンスパッタリングの1種であるヘリコンスパッタリング法を用いるのが好ましく、特に抵抗加熱式蒸着法が好ましい。この場合において、後記する透明導電膜はスパッタリング法による形成が好ましいので、装置やプロセスの共有化による利点を考慮して、適宜形成手段を選択することが好ましい。

【0015】なお、この構成の有機EL素子においては、電極のリード線は、金属薄膜あるいはその外側に形成される透明薄膜層から取ることとなり、金属薄膜、透明導電膜、電子注入電極層を通して、有機層に電子が注入される。

【0016】<透明導電膜>本発明で用いることができる透明導電膜は、前記の金属薄膜を積層させる構成を採用する場合には、ITO膜やSnO₂膜などの結晶質透明導電膜であってもよいが、この層自体の抵抗率も低い方が好ましく、具体的には抵抗率が $5 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることが好ましい。

【0017】このような透明導電膜として非晶質透明導電膜が挙げられる。このような非晶質透明導電膜の材質としては、In-Zn-O系の酸化物膜が好ましい。ここで、In-Zn-O系の酸化物膜とは、主要カチオン元素としてインジウム(In)及び亜鉛(Zn)を含有する非晶質酸化物からなる透明導電膜である。Inの原子比[In/(In+Zn)]は、導電性の点で0.50~0.90が特に好ましく、0.70~0.85が更に好ましい。

【0018】上記非晶質酸化物は、主要カチオン元素として実質的にIn及びZnのみを含有するものであってもよいし、その他に価数が正3価以上の1種以上の第3元素を含有するものであってもよい。前記第3元素的具体例としては、スズ(Sn)、アルミニウム(Al)、アンチモン(Sb)、ガリウム(Ga)、ゲルマニウム(Ge)、チタン(Ti)等があげられるが、導電性が向上するという点でSnを含有するものが特に好ましい。また、第3元素の含有量は、その総量の原子比

[(全第3元素)/(In+Zn+(全第3元素))]が0.2以下となる量が好ましい。第3元素の総量の原子比が0.2を超えると、イオンの散乱により導電性が低くなる場合がある。第3元素の総量の特に好ましい原子比は0.1以下である。なお、組成が同じであっても、結晶化したものは非晶質のものより導電性に劣るので、

この点からも非晶質の透明導電膜を使用するのが好ましい。

【0019】上述の酸化物は、薄膜にすることで透明導電膜として利用可能となる。このときの膜厚は、概ね3~3000nmとするのが好ましい。それは、3nm未満では導電性が不十分となりやすく、3000nmを超えると光透過性が低下したり、有機EL素子を製造する過程や製造後において故意又は不可避的に有機EL素子を変形させたときに透明導電膜にクラック等が生じやすくなる。透明導電膜の特に好ましい膜厚は5~1000nmであり、更に好ましい膜厚は10~800nmである。

【0020】本発明の有機EL素子において、基板上に陽極および有機層を介して陰極が形成される場合、電子注入電極層の上に透明導電膜(酸化物膜)が形成される。透明導電膜の形成手法としては、スパッタリング法の他、化学蒸着法、ゾルゲル法、イオンプレーティング法等を採用できるが、有機層への熱的影響が少ないことや簡便性の観点より、スパッタリング法が好ましい。この場合、スパッタリング時に発生するプラズマにより有機層が損傷を受けないように注意する必要がある。また、有機層の耐熱性は低いので、基板の温度を200°C以下とするのが好ましい。

【0021】スパッタリングの方法は、R FあるいはDCマグネットロンスパッタリング等でも反応性スパッタリングやECRスパッタリング、イオンビームスパッタリングでもよい。使用するスパッタリングターゲットの組成やスパッタリングの条件は、成膜しようとする透明導電膜の組成等に応じて適宜選択される。前記したような熱的影響を避けるためには、マグネットロンスパッタリングの一一種であるヘリコンスパッタリングを用いるのが好適である。

【0022】R FまたはDCマグネットロンスパッタリングあるいはヘリコンスパッタリング等によりIn-Zn-O系の透明導電膜を形成させる場合には、下記(i)~(ii)のスパッタリングターゲットを用いることが好ましい。

(i) 酸化インジウムと酸化亜鉛との組成物からなる焼結体ターゲットで、インジウムの原子比が所定のもの。
40 ここで、「インジウムの原子比が所定のもの」とは、最終的に得られる膜におけるInの原子比[In/(In+Zn)]が0.45~0.90の範囲内の所望値となるものを意味するが、焼結体ターゲットにおける原子比が概ね0.50~0.90のものである。この焼結体ターゲットは、酸化インジウムと酸化亜鉛との混合物からなる焼結体であってもよいし、In₂O₃ (ZnO)_m (m=2~20)で表される六方晶層状化合物の1種以上から実質的になる焼結体であってもよいし、In₂O₃ (ZnO)_m (m=2~20)で表される六方晶層状化合物の1種以上とIn₂O₃及び/又はZnOとから

実質的になる焼結体であってもよい。なお、六方晶層状化合物を表す前記式において m を $2 \sim 20$ に限定する理由は、 m が前記範囲外では六方晶層状化合物とならないからである。

【0023】(ii) 酸化物系ディスクと、このディスク上に配置した1種以上の酸化物系タブレットとからなるスパッタリングターゲット。酸化物系ディスクは、酸化インジウム又は酸化亜鉛から実質的になるものであってもよいし、 $In_2O_3 (ZnO)_m$ ($m = 2 \sim 20$) で表される六方晶層状化合物の1種以上から実質的になる焼結体であってもよいし、 $In_2O_3 (ZnO)_m$ ($m = 2 \sim 20$) で表される六方晶層状化合物の1種以上と In_2O_3 及び／又は ZnO とから実質的になる焼結体であってもよい。また、酸化物系タブレットとしては、上記酸化物系ディスクと同様のものを使用することができる。酸化物系ディスク及び酸化物系タブレットの組成並びに使用割合は、最終的に得られる膜における In の原子比 [$In / (In + Zn)$] が $0.45 \sim 0.80$ の範囲内の所望値となるように適宜決定される。

【0024】前記(i)～(ii)のいずれのスパッタリングターゲットもその純度は98%以上であることが好ましい。98%未満では、不純物の存在により、得られる膜の耐湿熱性(耐久性)が低下したり、導電性が低下したり、光透過性が低下したりすることがある。より好ましい純度は99%以上であり、更に好ましい純度は99.9%以上である。

【0025】また、焼結体ターゲットを用いる場合、このターゲットの相対密度は70%以上とすることが好ましい。相対密度が70%未満では、成膜速度の低下や膜質の低下をまねき易い。より好ましい相対密度は85%以上であり、更に好ましくは90%以上である。

【0026】スパッタリング法により透明導電膜を設ける場合のスパッタリング条件は、ダイレクトスパッタリングの方法やスパッタリングターゲットの組成、用いる装置の特性等により種々変わってくるために一概に規定することは困難であるが、DCマグнетロンスパッタリング法による場合には例えば下記のように設定することが好ましい。スパッタリング時の真空中度は $1.3 \times 10^{-2} \sim 6.7 \times 10^0$ Pa程度、より好ましくは $1.7 \times 10^{-2} \sim 1.3 \times 10^0$ Pa程度、更に好ましくは $4.0 \times 10^{-2} \sim 6.7 \times 10^{-1}$ Pa程度とする。また、ターゲットの印加電圧は200V～700Vが好ましい。スパッタリング時の真空中度が 1.3×10^{-2} Pa未満(1.3×10^{-2} Paよりも圧力が低い)ではプラズマの安定性が悪く、 6.7×10^0 Paよりも高い(6.7×10^0 Paよりも圧力が高い)とスパッタリングターゲットへの印加電圧を高くすることができなくなる。また、ターゲット印加電圧が200V未満では、良質の薄膜を得るのが困

難になったり、成膜速度が制限されることがある。

【0027】雰囲気ガスとしては、アルゴンガス等の不活性ガスと酸素ガスとの混合ガスが好ましい。不活性ガスとしてアルゴンガスを用いるばあい、このアルゴンガスと酸素ガスとの混合比(体積比)は概ね $1:1 \sim 9.9:0.01$ 、好ましくは $9:1 \sim 99.9:0.1$ とする。この範囲を外れると、低抵抗かつ光線透過率の高い膜が得られない場合がある。

【0028】基板温度は、有機層の耐熱性に応じて、当該有機層が熱により変形や変質を起こさない温度の範囲内で適宜選択される。基板温度が室温未満では冷却用の機器が別途必要になるため、製造コストが上昇する。また、基板温度を高温に加熱するにしたがって、製造コストが上昇する。このため、室温～200°Cとするのが好ましい。前記した(i)～(ii)等のスパッタリングターゲットを用いて上述したような条件でDCマグネットロンスパッタリングを行うことにより、目的とする透明導電膜を有機層上に設けることができる。

【0029】本発明の第2の目的を達成する有機EL素子においては、陰極を構成する透明導電膜に非晶質透明導電膜を使用することが必要である。この非晶質透明導電膜の材質、膜厚、形成法等については前記と同様である。

【0030】有機EL素子を用いた表示装置においては、一般に線状に形成された陽極と陰極をXYマトリックスに構成し、その交点領域に画素を形成させる。従って、高精細な表示を可能とするには、電極(陽極および陰極)を細く形成する必要がある。具体的には、電極を薄膜状に形成させた後、エッチング等によりライン状に30 パターニングして電極を作製する。この場合、隣接する電極が接触すると、画素の形成が阻害されることとなり、好ましくない。

【0031】このような高精細なパターニングにおいて、非晶質透明導電膜、特に $In-Zn-O$ 系の酸化物を用いて作製した非晶質透明導電膜を用いると、断面を台形状(テーパー状)とするエッチングが可能となり、基板上に陽極側から積層する場合には、この上に形成される金属薄膜に段差切れが生じることを抑制することができる。また、高精細な有機EL表示装置の作製が可能となる。また、基板上に陰極側から積層して有機EL素子を作成する場合には、陰極上に積層される有機層やその上に積層される陽極に段差切れが生じることを抑制することができる。

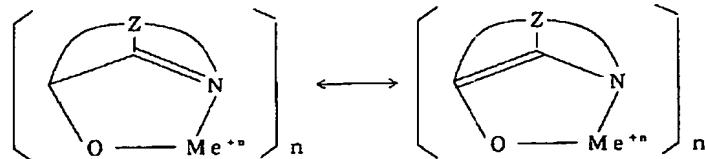
【0032】透明導電膜をテーパー状にエッチングする方法としては、ドライエッチング加工が好ましく、ライン状に形成された透明導電膜の底面と側面で形成される角度(θ)が30～60度となるように加工するのが好ましい。エッチングガスとしては、例えば、メタンと塩化水素の混合ガスを用いることができる。透明導電膜を50 テーパー状に加工した有機EL素子を模式的に表したもの

の一例を、図2に示す。

【0033】<電子注入電極層>次に、電子注入電極層について説明する。電子注入電極層とは、発光層を含む有機層に良好に電子注入ができる電極の層である。透明発光素子を得るために、光線透過率が80%以上であることが好ましく、このためには膜厚を0.5~20nm程度の超薄膜とすることが望ましい。

【0034】電子注入電極層としては、例えば、仕事関数3.8eV以下の金属（電子注入性の金属）、例えば、Mg, Ca, Ba, Sr, Li, Yb, Eu, Y, Scなどを用いて膜厚を1nm~20nmとした層を挙げることができる。この場合において、特に60%以上の光線透過率を与える構成が好ましい。他の好ましい例としては、前記の仕事関数3.8eV以下の金属（複数種でもよい。）と仕事関数4.0eV以上の金属との合金（電子注入性の合金）を用いた電子注入電極層を挙げることができる。このような合金としては、電子注入電極層の形成が可能な合金であれば足りるが、例えば、アルミニウムーリチウム合金、マグネシウムーアルミニウム合金、インジウムーリチウム合金、鉛ーリチウム合金、ビスマスリチウム合金、スズリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アルミニウムーバリウム合金、アルミニウムースカンジウム合金を挙げることができる。この場合においても、膜厚を1nm~20nmとすることが好ましく、特に60%以上の光線透過率を与える層とすることが好ましい。

【0035】前記の金属または合金を用いて電子注入電極層を形成させる場合、好適には抵抗加熱蒸着法を用いる。この場合、基板温度を10~100°Cの間で設定し、蒸着速度を0.05~20nm/秒の間に設定するのが好ましい。また、特に合金を蒸着する場合には、2元蒸着法を用い、2種の金属の蒸着速度を個別に設定して蒸着することができる。この場合、Li, Ba, Ca, Sc, Mgなどの蒸着速度を0.01~0.1nm/秒の間に設定し、Al等の母体金属の蒸着速度を1~10nm/秒の間に設定して同時に蒸着するという手



【0040】(式中、Meは金属を表し、nは1~3の整数である。Zは独立にそれぞれの場合において少なくとも2個の縮合芳香族環を持つ核を完成する原子を示す。)

式中の金属としては、キレート形成能のある1~3価金属であればよく、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウムのようなアルカリ金属、マグネシウムやカルシウムのようなアルカリ土類金属、あるいはホウ素やアルミニ

法が採用できる。また、合金を蒸着する場合に、1元蒸着法を用いることもできる。この場合、予め所望の割合で電子注入性の金属を母体金属に仕込んだ蒸着ペレットまたは粒状体を抵抗加熱ポートやフィラメントに設置し、加熱蒸着する。

【0036】更に別の好ましい形態としては、薄膜状の電子注入性のアルカリ土類金属酸化物であって、膜厚が0.1nm~10nmの超薄膜を挙げることができる。前記アルカリ土類金属酸化物としては、例えば、Ba

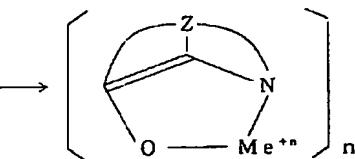
10 O, SrO, CaO及びこれらを混合した、Ba, Sr_{1-x}O (0 < x < 1) やBa, Ca_{1-x}O (0 < x < 1) を好ましくものとして挙げることができる。

【0037】アルカリ土類金属酸化物層の形成手法としては、抵抗加熱蒸着法によりアルカリ土類金属を蒸着しながら、真空槽内に酸素を導入して真空度を10⁻³~10⁻⁴Paとし、酸素とアルカリ土類を反応させながら蒸着させる方法が好ましい。また、アルカリ土類金属酸化物を電子ビーム蒸着法により製膜する方法を採用することもできる。なお、これまで説明した、電子注入性の金属、合金、アルカリ土類金属酸化物については、1種のみでなく2種以上を用いて電子注入電極層を形成することもできる。

【0038】更に他の好ましい例として、電子注入電極層は、電子注入性の金属、合金あるいはアルカリ土類金属酸化物と電子伝達性の化合物との混合層であってよい。電子注入性の金属、合金、アルカリ土類金属酸化物としては、前記した金属、合金、アルカリ土類金属酸化物を挙げることができる。また、これらは、1種のみでなく2種以上を用いることもできる。一方、電子伝達性の化合物は、電子を伝達する化合物であればよく、好ましい化合物として、キレート化オキシノイド化合物を挙げることができ、更に好適な化合物として下式で表されるものが挙げられる。

【0039】

【化1】



ウムのような3価金属を挙げることができる。また、Zは少なくとも2個の縮合芳香族環を持つ複素環状核を完成する原子を表す。Zが完成する複素環状核としては、例えば、アゾール環やアジン環を挙げることができる。

【0041】前記有用なキレート化オキシノイド化合物としては、アルミニウムトリスオキシン、マグネシウムビスオキシン、ビス〔ベンゾ(f)-8-キノリノール〕亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)ア

ルミニウムオキサイド、インジウムトリスオキシン、アルミニウムトリス（5-メチルオキシン）、リチウムオキシン、ガリウムトリスオキシン、カルシウムビス（5-クロロオキシン）、ポリ〔亜鉛（II）-ビス（8-ヒドロキシ-5-キノリノイル）メタン〕、ジリチウムエピンドリジョン等が挙げられる。

【0042】また、電子注入性の金属、合金、アルカリ土類金属酸化物と電子伝達性の化合物との混合比（重量比）は、100:1~1:2とすることが好ましい。電子注入性の金属、合金と電子伝達性の化合物との混合層は、2元同時蒸着法により形成するのが好ましい。基板温度は、10~100°Cの間で設定すればよい。

【0043】更に他の好ましい例として、電子注入電極層が島状の電子注入域である構成を挙げることができる。ここで、島状とは、例えば図3に示すように、不連続に電子注入性化合物層が形成されていて、この層は有機層の表面を覆いつくすことがないことを意味する。島状電子注入域は、例えば仕事関数3.8eV以下の低仕事関数の金属、酸化物、ホウ化金属、窒化金属、ケイ化金属などを島状に不連続に形成させたものであり、その形状及び大きさについては特に制限はないが、微粒子状または結晶状であって、大きさが0.5nm~5μm程度のものが好ましい。

【0044】また、この電子注入域は、薄膜状を指すものでも、孤立原子分散の状態を示すものでもない。上記の低仕事関数の金属又は化合物が、粒子状の形態で導電性薄膜上又は有機化合物層内に分散されている状態を指す。このような分散により、有機化合物層と接触している面積が大きくなり、電子注入性が高まる。上記島状電子注入域を構成する低仕事関数の金属及び合金としては、仕事関数3.8eV以下のものが好ましく、例えば、前記した金属及び合金を挙げができる。また、低仕事関数の酸化物としては、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の酸化物が好ましく、特にCaO、BaO、SrOなどが好適であり、また、これらと他の金属酸化物との固溶体も好ましく挙げができる。更に、低仕事関数のホウ化金属や窒化金属としては、例えば希土類のホウ化物、希土類のケイ化物あるいはTINなどが好ましく挙げられる。

【0045】島状電子注入域の形成方法としては、抵抗加熱蒸着法や電子ビーム蒸着法を採用することができる。後者の場合、高融点のホウ化金属、窒化金属または酸化物を電子ビーム蒸着により島状に不連続に形成させる。本発明の有機EL素子において、電子注入電極層と非晶質透明導電膜を構成要素とする陰極の場合、劣化し易い電子注入電極層が非晶質透明導電膜で保護されることとなり、電子注入電極層を薄くすることができ、結果として、透明陰極を好適に作成できるという利点を有する。

【0046】本発明の有機EL素子においては、通常、

基板上に陽極を積層しその上に有機層を積層する構成を採用するが、この場合、有機発光層を含む有機層の上に電子注入電極層を形成する。形成方法は、前記のとおりであるが、他の好ましい方法としてスパッタリング法があるが、この手法を用いるに際しては、プラズマにより有機層が損傷を受けないように注意する必要がある。

【0047】<透明薄膜層>前記の構成の陰極においては、最外層が金属薄膜となるため、これを保護する層が必要となる。本発明の第1の目的は、光透過性を有する陰極を得ることにあるため、この層は光透過性を有する必要がある。このような、層としてガラスやプラスチック製の公知の薄膜を用いることもできるが、基板上に陽極側から積層して有機EL素子を作製する場合には、金属薄膜上に、透明な誘電体薄膜あるいは透明導電膜を形成するのが好ましい。誘電体薄膜を用いる場合には、屈折率の関係で光透過率が向上した透明保護膜を形成することができるという利点がある。

【0048】透明な誘電体薄膜としては、例えば、TiO₂等の結晶性薄膜を用いることができる。また、透明導電膜としては、例えば、ITO、SnO₂等の結晶性の薄膜やIn-Zn-O系等の非晶質透明導電膜を使用することができる。特に、非晶質透明導電膜を用いることは本発明の第2の目的である耐久性の向上の面でも好ましい。この層においては、導電性を必須としない。そのため、透明な誘電体薄膜を用いる場合、リードは金属薄膜からとることになる。この層の形成方法としては、RFマグネットロンスパッタリング、特にヘリコンスパッタリングが好適に用いられる。

【0049】<光透過率および面抵抗値>本発明の第1の目的を達成する有機EL素子においてはまた、陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されるとともに、陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなる構成であって、陰極と前記透明薄膜層からなる層の光透過率が60%以上であり、かつ陰極と前記透明薄膜層からなる層または陰極の面抵抗値が10Ω/□以下である素子構成を採用することができる。この構成を満たす陰極としては、例えば、前記の構成を有するものを好適に挙げができる。また、透明薄膜層は、前記と同様である。

【0050】ここで規定する光透過率とは、有機EL素子を構成する有機層に接する層（例えば、電子注入電極層）から陰極の外側に形成される透明薄膜までの光透過率である。光透過率は、可視光域（380~700nm）のいずれか波長で透過率が60%以上となればよい。光透過率の測定方法としては、公知の分光光度計を用いればよい。また、陰極とその外側に形成される透明薄膜層からなる層のみを作製して光透過率を測定する必要はなく、他の層を含めた光透過率が60%以上であれば、この層の光透過率が60%以上であるといえる。

【0051】ここで規定する面抵抗値（Ω/□）は、四

探針法により測定した値である。具体的には、絶縁性の基板（例えば、ガラス基板）上に、当該有機EL素子における陰極およびその外側に形成される透明薄膜層からなる層と同じ構成の膜、または陰極と同じ構成の膜を形成し、四探針法により陰極またはその外側に形成される透明薄膜層表面の面抵抗値を測定する。このとき、面抵抗値を測定する層としては、電極リードを取り出す層を選択する。即ち、陰極から電極リードを取り出す場合は、陰極の面抵抗を測定し、陰極の外側に形成される透明薄膜層から電極リードを取り出す場合には、透明薄膜層の面抵抗を測定する。このようにして、測定された面抵抗値が本発明の規定する面抵抗値である。

【0052】ただし、陰極が電子注入電極層を含む構成の場合には、該層を除外した層を実際の素子構成の場合と同じ順序で積層して面抵抗を測定する。具体的には、例えば、透明薄膜層から電極リードを取り出すEL素子の場合には、支持基板（通常はガラス）上に、透明導電膜、金属薄膜、透明薄膜層の順に積層し、この透明薄膜層の表面の面抵抗を本発明の面抵抗値とする。この場合において、金属薄膜から電極リードを取り出す場合には、金属薄膜の表面の面抵抗を本発明の面抵抗値とする。

【0053】<有機層>本発明の有機EL素子において、陽極と陰極との間に介在する有機層は、少なくとも有機発光層を含む。有機層は、有機発光層のみからなる層であってもよく、また、有機発光層とともに、正孔注入輸送層などを積層した多層構造のものであってもよい。

【0054】この有機EL素子において、発光層は（1）電界印加時に、陽極又は正孔輸送層により正孔を注入することができ、かつ電子注入電極層より電子を注入することができる機能、（2）注入した電荷（電子と正孔）を電界の力で移動させる輸送機能、（3）電子と正孔の再結合の場を発光層内部に提供し、これを発光につなげる発光機能などを有している。この発光層に用いられる発光材料の種類については特に制限はなく、従来有機EL素子における公知のものを用いることができる。

【0055】また、正孔注入輸送層は、正孔伝達化合物からなる層であって、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入輸送層を陽極と発光層との間に介在させることにより、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入される。その上、電子注入層より発光層に注入された電子は、発光層と正孔注入輸送層の界面に存在する電子の障壁により、この発光層内の界面近くに蓄積されたEL素子の発光効率を向上させ、発光性能の優れたEL素子とする。この正孔注入輸送層に用いられる正孔伝達化合物については特に制限はなく、従来有機EL素子における正孔伝達化合物として公知のものを使用することができる。正孔注入輸送層は、単層

のみでなく多層とすることもできる。

【0056】<陽極>陽極は、仕事関数が4.8eV以上の導電性を示すものであれば特に制限はない。仕事関数が4.8eV以上の金属又は透明導電膜（導電性酸化物膜）又はこれらを組み合わせたものが好ましい。陽極は、必ずしも透明である必要はなく、黒色のカーボン層等をコーティングしてもよい。

【0057】好適な金属としては、例えば、Au、Pt、Ni、Pdを挙げることができ、導電性酸化物としては、例えば、In-Zn-O、In-Sn-O、ZnO-Al、Zn-Sn-Oを挙げができる。また、積層体としては、例えば、AuとIn-Zn-Oの積層体、PtとIn-Zn-Oの積層体、In-Sn-OとPtの積層体を挙げができる。

【0058】また、陽極は、有機層との界面が仕事関数4.8eV以上であればよいため、陽極を2層とし、有機層と接しない側に仕事関数4.8eV以下の導電性膜を用いてもよい。この場合、Al、Ta、W等の金属やAl合金、Ta-W合金等の合金等を用いることができる。また、ドープされたポリアニリンやドープされたポリフェニレンビニレン等のドープされた導電性高分子や、 α -Si、 α -SiC、 α -Cなどの非晶質半導体、 μ C-Si、 μ C-SiC等の微結晶なども好ましく用いることができる。更には、黒色の半導性の酸化物であるCr₂O₃、Pr₂O₅、NiO、Mn₂O₃、MnO₂等を用いることができる。

【0059】陽極の膜厚は、50～300nm程度とすることが好ましい。膜厚が50nm未満では、抵抗値が高くなり過ぎる場合がある。一方、300nmを超えると、有機EL素子において、陽極がパターンされている端で生じる段差により上部の膜、例えば有機層や陰極が段差切れや断線を起こす場合がある。

【0060】<有機EL素子の構成>本発明の有機EL素子は、陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が介在しており、陰極は電子注入電極層、透明導電膜、金属薄膜とによって構成されており、しかも電子注入電極層が有機層と接するとともに陰極の外側に透明薄膜層が形成されてなる構成、あるいは陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されるとともに陰極とその外側に形成される透明薄膜からなる層の光透過率が60%以上であり、かつ陰極と前記透明薄膜層からなる層または陰極の面抵抗値が10Ω/□以下である構成を具備していれば、本発明の第1の目的を達成することができる。また、上記の有機EL素子において透明導電膜として非晶質透明導電膜を採用することにより本発明の第2の目的を達成することができる。

【0061】また、更に他の構成を付加して、種々の機能を持たせることができる。以下に本発明の有機EL素子を利用した構成を例示する。

① 透明陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導

電膜／金属薄膜／透明導電膜

② 陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導電膜／金属薄膜／透明導電膜／カラーフィルター

③ 陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導電膜／金属薄膜／透明導電膜／色変換層

④ 透明陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導電膜／金属薄膜／透明導電膜／黒色光吸收層

⑤ 透明陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導電膜／金属薄膜／透明導電膜／背景色形成層

⑥ 黒色光吸收層／透明陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導電膜／金属薄膜／透明導電膜

⑦ 背景色形成層／透明陽極／有機層／電子注入電極層／非晶質透明導電膜／金属薄膜／透明導電膜

前記①の構成の場合、両方の電極が透明なので、透明表示素子が形成される。

【0062】②や③の構成の場合、陽極を支持基板上に形成し、支持基板とは逆方向に発光の取り出しができるので、カラーフィルターや色変換層上に陽極を形成する必要がない。従って、陽極を形成する際に基板温度が150°C以上となるようなプロセスを採用することができ、陽極の抵抗値を下げる上で大きなメリットがある。また、カラーフィルターや色変換層は陽極形成後に形成されるため、高温プロセスの採用による劣化を心配する必要がない。図4に、②の構成を例示する。なお、ここで、色変換層としては、蛍光性色素を含有する透明性ポリマーからなり、EL発光色を蛍光により別の色に変換するものであることが好ましい。

【0063】また、②や③の構成で、多くの画素を構成させた態様においては、基板上に陽極以外の補助配線やTFT (Thin Film Transistor) が形成されるため、基板方向に光を取り出すと、補助配線やTFTが光を遮断し、光取り出しの開口率が落ち、結果としてディスプレイの輝度が小さくなり、画質が落ちるという欠点がある。本発明を用いれば基板とは逆の方向に光の取り出しができるが、この場合には光が遮断されず光取り出しの開口率が落ちない。

【0064】④や⑥の構成においては、画素がオフのときに黒色に見えるので、入射外光が反射せず、ディスプレイのコントラストが向上するという利点がある。図5に、④の構成を例示する。⑤や⑦の構成においては、種々の背景色や図柄を採用することができ、画素がオフのときにも装飾性に優れるディスプレイとすることができる。図6に、⑦の構成を例示する。

【0065】なお、前記②～⑦の構成において、色変換層、カラーフィルター、黒色光吸收層及び背景色形成層は、必ずしも電極に密着する必要はなく、中間層を介在させてよいし、その効果が発現される限り、図4に示すように離して設置してもよい。ただし、色変換層やカラーフィルターは光取り出し方向に設置される必要があり、黒色光吸收層や背景色形成層は光取り出し方向とは

逆方向に設置される必要がある。

【0066】

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。

【実施例1】

<有機EL素子の作製> 25mm×75mm×1mmのガラス基板上に、ITOを100nmの膜厚で製膜したもの（ジオマティックス社製）を基板上に導電性薄膜（陽極）が成膜してあるものとして使用した。次に、これをイソプロピルアルコール中に浸漬し、超音波洗浄を行った後、サムコインターナショナル製の紫外線照射機UV-300を用いて紫外線とオゾンとを併用して30分間洗浄した。

【0067】次いで、このITO薄膜付きガラス基板を、市販の真空蒸着装置の中に入れ、この装置に設置されている基板ホルダーに取り付け、真空槽を 5×10^{-4} Paまで減圧した。なお、あらかじめ真空蒸着装置の抵抗加熱ポートには、Cu配位のフタロシアニン（以下、CuPcと略記する。）、N,N'-ビス（3-メチルフェニル）-N,N'-ジフェニル-(1,1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン（以下、TPDと略記する。）及び8-キノリノールアルミニウム錯体（アルミニウムトリスオキシン、以下、Alqと略記する。）をそれぞれ200mgずつ入れ、また抵抗加熱フィラメントにはアルミニウム-リチウム合金（Li含量：2重量%）を入れておいた。これらのポートおよびフィラメントを順次加熱することにより、それぞれの成分を蒸着した。

【0068】まず、正孔注入輸送層としてCuPcをITO薄膜付きガラス基板に25nm蒸着し、次に第2の正孔注入輸送層としてTPDを40nm蒸着し、更に発光層としてAlqを60nm蒸着した。次に、形成された積層体の上にマスクを設置し、アルミニウム-リチウム合金を7nm蒸着して電子注入電極層を形成させた。

【0069】次に、上記真空蒸着装置に連結されている別の真空槽の基板ホルダーに基板を移送しセットした。なお、この間真空度は保たれたままである。上記、別の真空槽はDCマグネットロンスパッタリングによりIn-Zn-O系酸化物膜を形成できるように設備されている。In-Zn-O系酸化物膜を形成させるためのターゲットは、In₂O₃とZnOとからなる焼結体であり、Inの原子比[In/(In+Zn)]は0.67である。この真空槽のアルゴンガスと酸素ガスの混合ガス（体積比1000:2.8）を 3×10^{-4} Paとなるまで導入し、スパッタリング出力を20W、基板温度を室温に設定して膜厚100nmの非晶質透明導電膜を形成させた。なお、In-Zn-O系酸化物膜が非晶質であることは、ITO薄膜が蒸着されていないガラス基板を用いて上記と同様の方法により積層体を形成し、X線回折により確認した。

【0070】次に、雰囲気ガスをアルゴンとし、その圧

力を 3×10^{-1} Pa とし、スパッタリング出力を 10 W、基板温度を室温に設定して DC マグネットロンスパッタリングにより、銀 (Ag) を 5 nm 積層した。その後更に、上記と同じ条件により In-Zn-O 系酸化物膜を 100 nm 積層し、有機 EL 素子を作製した。

【0071】<光透過率および面抵抗値の評価>前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ITO 薄膜付きガラス基板上に直接、電子注入電極層、非晶質透明導電膜、銀薄膜、In-Zn-O 系酸化物膜を積層した積層体を作成し、分光光度計を用いて波長 460 nm の光の透過率を計測したところ、60% と高透明のものであった。更に、前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ガラス基板上に直接、非晶質透明導電膜と銀薄膜を積層し、その上に In-Zn-O 系酸化物膜を積層して、この酸化物膜表面の面抵抗値を、三菱油化社製のロレスタ FP を用いて測定したところ、 $10\Omega/\square$ であった。

【0072】<有機 EL 素子の評価>次に、ITO 薄膜を陽極とし、In-Zn-O 系酸化物膜から電極リードを取り、両薄膜間に電圧を 7 V 印加したところ、 $2.8\text{ mA}/\text{cm}^2$ の電流密度となり、陰極側より観測したところ、 $60\text{ cd}/\text{m}^2$ の発光があった。発光は、A1q より生じた緑色発光であった。更に、この素子を大気中、70% RH (相対湿度) の雰囲気に 100 時間放置したところ、無発光点は肉眼では観測されず、素子の発光性能も維持されていた。

【0073】[比較例 1]

<有機 EL 素子の作製>実施例 1 と同様の方法により有機 EL 素子を作製した。ただし、電子注入電極層の上に非晶質透明導電膜、銀薄膜、In-Zn-O 系酸化物膜からなる三層の薄膜を形成させる代わりに、市販の ITO ターゲットを用いて、200 nm の一層の ITO 膜を形成させた。この ITO 膜を形成させる際、雰囲気ガスとその圧力、およびスパッタリング方法および出力も実施例 1 と同様にした。

【0074】<光透過率および面抵抗値の評価>前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ITO 薄膜付きガラス基板上に直接、電子注入電極層および ITO 膜を形成させた積層体を作製し、実施例 1 と同様にして光の透過率を測定したところ 80% であった。更に、前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ガラス基板上に直接、ITO 膜を積層して、その表面の面抵抗値を、実施例 1 と同様の方法で測定したところ、 $130\Omega/\square$ であった。

【0075】<有機 EL 素子の評価>次に、この有機 EL 素子に電圧を 8 V 印加したところ、 $4\text{ mA}/\text{cm}^2$ の電流密度となり、非晶質透明導電膜側より観測したところ、 $60\text{ cd}/\text{m}^2$ の発光があった。発光は、A1q より生じた緑色発光であった。この素子を大気中、70% RH の雰囲気に 100 時間放置したところ、無発光点は

肉眼で無数確認され、発光欠陥が多いことが確認された。

【0076】以上の結果より、実施例 1 の有機 EL 素子は、陰極の透明性が高く、かつ陰極が低抵抗であるため発光効率が高く、更に最外層および電子注入電極層に接する層を構成する In-Zn-O 薄膜が非晶質であるため、耐久性に優れ、発光欠陥が生じにくいことが確認された。ところで、電子注入電極層の酸化により発光欠陥が生じることが知られている。本発明の有機 EL 素子では、最外層および電子注入電極層に接する層として非晶質透明導電膜が形成され、この透明導電膜には結晶粒界が存在しないため、酸素や水分の侵入が防止され前記の結果となったものと考えられる。一方、比較例 1 は陰極の透明性は高いものの、陰極の抵抗値が高いため発光効率に劣ることが確認された。

【0077】[実施例 2]

<有機 EL 素子の作製>実施例 1 において、最後に形成した In-Zn-O 系酸化物薄膜に代えて、ITO 薄膜を、DC マグネットロンスパッタリングにより膜厚 100 nm となるように形成させた以外は、実施例 1 と同様の方法により有機 EL 素子を作製した。ITO 薄膜は、ITO ターゲットをアルゴンガスと酸素ガスの混合ガス (体積比 1000 : 2.8) を 3×10^{-1} Pa となるまで導入し、スパッタリング出力を 20 W、基板温度を室温に設定して膜厚 100 nm の薄膜を形成させた。

<光透過率および面抵抗値の評価>前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ITO 薄膜付きのガラス基板上に直接、電子注入電極層、非晶質透明導電膜、銀薄膜、ITO 膜を積層した積層体を作成し、波長 460 nm の光の透過率を計測したところ、80% と高透明のものであった。更に、前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ガラス基板上に直接、非晶質透明導電膜と銀薄膜を積層し、その上に ITO 膜を積層して、この ITO 膜表面の面抵抗値を、実施例 1 と同様にして測定したところ、 $5\Omega/\square$ であった。

【0078】<有機 EL 素子の評価>次に、ガラス基板に直接積層された ITO 薄膜を陽極とし、最後に積層した ITO 膜から電極リードを取り、両薄膜間に電圧を 6 V 印加したところ、 $2.5\text{ mA}/\text{cm}^2$ の電流密度となり、陰極側より観測したところ、 $60\text{ cd}/\text{m}^2$ の発光があった。発光は、A1q より生じた緑色発光であった。更に、この素子を大気中、70% RH (相対湿度) の雰囲気に 100 時間放置したところ、無発光点は肉眼では観測されず、素子の発光性能も維持されていた。

【0079】[実施例 3]

<有機 EL 素子の作製>実施例 1 において、最初に形成した In-Zn-O 酸化物薄膜の膜厚を 200 nm とするとともに、最後に形成した In-Zn-O 酸化物薄膜に代えて、TiO_x を用い、RF マグネットロンスパッタリングにより膜厚 100 nm の薄膜を形成させた以外

は、実施例1と同様の方法により有機EL素子を作製した。TiO₂薄膜の形成の際には、雰囲気ガスとしてアルゴンガスを3×10⁻¹Paとなるまで導入し、スパッタリング出力を20W、基板温度を室温に設定して膜厚100nmの薄膜を形成させた。

【0080】<光透過率および面抵抗値の評価>前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ITO薄膜付きガラス基板上に直接、電子注入電極層、非晶質透明導電膜、銀薄膜、TiO₂薄膜を積層した積層体を作成し、波長460nmの光の透過率を計測したところ、85%と高透明のものであった。更に、前記した素子の作製方法と同様の方法を用いて、ガラス基板上に直接、非晶質透明導電膜と銀薄膜を積層し、銀薄膜表面の面抵抗値を、実施例1と同様にして測定したところ、10Ω/□であった。

【0081】<有機EL素子の評価>次に、ITO薄膜を陽極とし、銀薄膜から電極リードを取り、両薄膜間に電圧を7V印加したところ、3.0mA/cm²の電流密度となり、陰極側より観測したところ、80cd/m²の発光があった。発光は、A1qより生じた緑色発光であった。

【0082】更に、この素子を大気中、70%RH(相対湿度)の雰囲気に100時間放置したところ、無発光点は肉眼では観測されず、素子の発光性能も維持されていた。以上の結果より、実施例2、3の有機EL素子は、陰極の透明性が高く、かつ陰極が低抵抗であるため発光効率が高く、更に電子注入電極層に接する層を構成するIn-Zn-O薄膜が非晶質であるため、耐久性に優れ、発光欠陥が生じにくいことが確認された。

【0083】

【発明の効果】本発明の第1の目的を達成する有機EL素子は、低抵抗かつ高透明の陰極を有するため、発光を効率よく素子の両面から取り出すことができるとともに、高精細な表示装置に利用した場合にも、輝度ムラの発生が少なく、駆動時の応答の遅れが小さい。

【0084】本発明の第2の目的を達成する有機EL素子は、第1の目的を達成するとともに、陰極のテーパー

エッチング加工ができるため、高精細な有機EL発光装置の作製が容易である。また、本発明の第2の目的を達成する有機EL素子は、耐久性(耐湿熱性)に優れる。本発明の有機EL素子は以上のような効果を有するため、たとえば情報機器のディスプレイなどに好適に用いられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の有機EL素子の一例の構成を示す断面図である。

【図2】 本発明の有機EL素子において、断面テーパー状の非晶質透明導電膜を採用した場合の一例を示す断面図である。

【図3】 本発明の有機EL素子において、島状電子注入域が、非晶質透明導電膜と有機層との界面に存在する場合の一例を示す断面図である。

【図4】 本発明の有機EL素子の利用態様の一例を単純化して示したものであって、非晶質透明導電膜の外側にカラーフィルターを付加した構成を示す断面図である。

【図5】 本発明の有機EL素子の利用態様の一例を単純化して示したものであって、非晶質透明導電膜の外側に黒色吸収層を備えた構成を示す断面図である。

【図6】 本発明の有機EL素子の利用態様の一例を単純化して示したものであって、透明陽極の外側に背景色形成層を備えた構成を示す断面図である。

【符号の説明】

1：基板

2：陽極

3：有機層

4：電子注入電極層

5：透明導電膜

6：金属薄膜

7：透明薄膜層

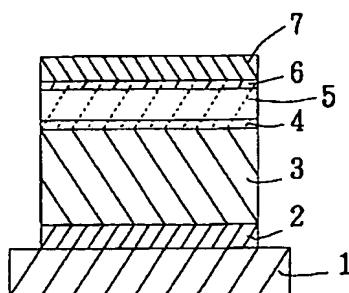
8：島状注入域

9：カラーフィルター

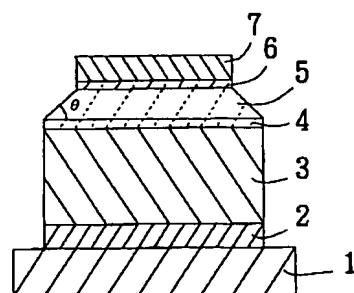
10：黒色光吸収層

11：背景色形成層

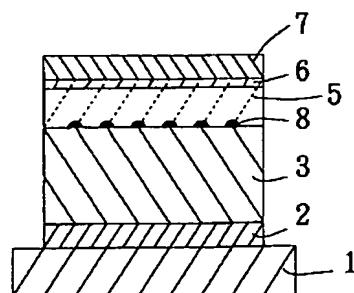
【図1】



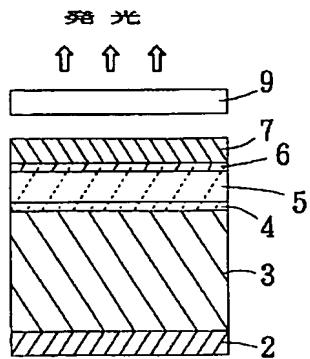
【図2】



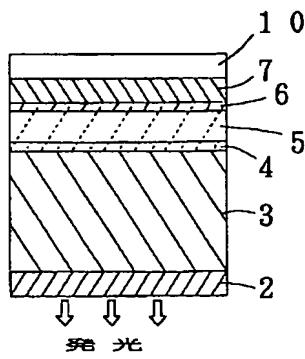
【図3】



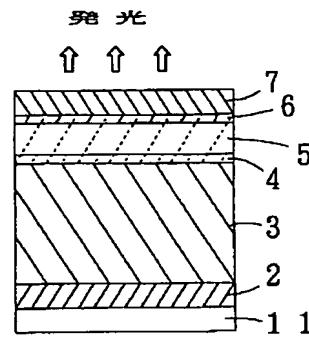
【図 4】



【図 5】



【図 6】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.